JROPEAN PATENT OFF E

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

2000281654

PUBLICATION DATE

10-10-00

APPLICATION DATE

26-03-99

APPLICATION NUMBER

11083022

APPLICANT: TANABE SEIYAKU CO LTD;

INVENTOR: YOSHIKAWA KOHEI;

INT.CL.

: C07D217/26 A61K 31/00 C07D401/04

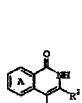
C07D401/12 C07D401/14 C07D405/12

C07D413/04 // A61K 31/47 A61K

31/495 A61K 31/505

TITLE

: ISOQUINOLINE DERTIVATIVE



Π

I

Ш

ABSTRACT: PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain an isoquinoline derivative which has an excellent selective phosphodiesterase V-inhibiting action, exhibits an excellent vasodilator action, an excellent pulmonary artery pressure-lowering action and the like on the basis of the action and is useful as a medicine for preventing and treating chronic heart failure, stenocardia, (pulmonary)hypertension and the like.

> SOLUTION: A compound of formula I [ring A is a substituted benzene ring; ring B is a (substituted) benzene ring; R1 is a (substituted) lower alkoxy, a (substituted) cyclo lower alkyloxy, a (substituted) alkenyloxy or the like; R2 is COOR3 (R3 is H or an ester residue) or CON(R4)(R5) [N(R4)(R5) is a (substituted)nitrogen-containing heterocyclic group or (substituted) amino]], for example,

> 7-benzyloxy-1-chloro-3-methoxycarbonyl-4-(3,4,5-trimethoxyphenyl) isoquinoline. The compound of formula I is produced, for example, by a method comprising halogenating an isoquinoline derivative (salt) of formula II to obtain a compound of formula III (R11 is a halogen).

COPYRIGHT: (C)2000,JPO

VISDOCID: <JP 2000281654A AJ >

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-281654 (P2000-281654A)

(43)公開日 平成12年10月10日(2000.10.10)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号		FΙ				7	·-マコード(参考)
C 0 7 D 217/26		C 0	7 D 21	7/26			4 C 0 3 4	
A 6 1 K 31/00	609		A 6	1K 3	1/00		609B	4 C 0 6 3
							609G	4 C 0 8 6
							609J	
	6 1 5						615G	
		審査請求	未請求	請求項	の数7	OL	(全 49 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号	特願平11-83022	,	(71)	出顧人	000002	2956		
			ļ		田辺繁	薬株式	会社	
(22)出願日	平成11年3月26日(1999	11年3月26日(1999.3.26)			大阪府	大阪市	中央区道修町	3丁目2番10号
			(72)	発明者				
	=				兵庫県	神戸市	東灘区向洋町	中6丁目6番
					611の2	202		
			(72)	発明者	山田	幸一郎		
					埼玉県	南埼玉	郡白岡町新白	岡3丁目34番地
					7			
		•	(72)	発明者	大森	謙司		
					埼玉県	浦和市	元町1丁目16	番6号
			(74)	代理人	100076	923		
					弁理士	箕浦	繁夫	
								最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 イソキノリン誘導体

(57)【要約】

(修正有)

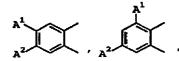
【課題】 優れたPDE V阻害作用に基づく循環器系 疾患の予防・治療剤として有用であるイソキノリノン誘 導体を提供する。

【解決手段】 一般式[I]

(式中、環Aは、置換されたベンゼン環、環Bは、置換もしくは非置換ベンゼン環、R¹は、置換もしくは非置換の低級アルコキシ基、シクロ低級アルキルオキシ基、アルケニルオキシ基、低級アルキニルオキシ基、アリールオキシ基、複素環式基置換オキシ基、低級アルキルチオ基、アリールチオ基、低級アルキル基、アミノ基、複素環式基、アリール基、及びシアノ基又はハロゲン原子、R²は、式:-COR³又は式:-CON(R⁴)(R⁵)で示される基、R³が水素原子またはエステル残

基、-N(R⁴)(R⁵)で示される基が置換もしくは非 置換含窒素複素環式基または置換もしくは非置換アミノ 基を表わす。)で示されるイソキノリン誘導体またはそ の薬理的に許容しうる塩。 【特許請求の範囲】 【請求項1】 一般式[I] 【化1】

(式中、環Aは、置換されたベンゼン環、環Bは、置換 もしくは非置換ベンゼン環、R1は、置換もしくは非置 換低級アルコキシ基、置換もしくは非置換シクロ低級ア ルキルオキシ基、置換もしくは非置換低級アルケニルオ キシ基、置換もしくは非置換低級アルキニルオキシ基、



で示されるベンゼン環であり、環Bが、式: 【化3】

$$B^1$$
 B^3

で示されるベンゼン環であり、A1が保護されていても よい水酸基、ハロゲン原子、置換もしくは非置換低級ア ルキル基、置換もしくは非置換低級アルケニル基、低級 アルキルカルバモイルオキシ基、ジ低級アルキルカルバ モイルオキシ基または式:R6-(CO)。-O-で示さ れる基であり、A2が保護されていてもよい水酸基、ハ ロゲン原子、置換もしくは非置換低級アルキル基、置換 もしくは非置換低級アルケニル基、低級アルキルカルバ モイルオキシ基、ジ低級アルキルカルバモイルオキシ基 または式: R6-(CO)_n-O-で示される基である か、またはA1及びA2が互いに末端で結合して低級アル キレンジオキシ基を形成し、R6が置換もしくは非置換 低級アルキル基、置換もしくは非置換低級アルケニル 基、置換もしくは非置換シクロ低級アルキル基、置換も しくは非置換アリール基、置換もしくは非置換アリール スルホニル基または置換もしくは非置換複素環式基であ り、nはOまたは1であり、B1、B2及びB3が、同一 または異なって、保護されていてもよい水酸基、低級ア ルコキシ基、低級アルキル基またはハロゲン原子である か、あるいは、いずれか2つが互いに末端で結合して低 級アルキレンジオキシ基を形成し、R2が低級アルコキ シカルボニル基である請求項1記載の化合物。

【請求項3】 環Aが、式: 【化4】

置換もしくは非置換アリールオキシ基、置換もしくは非 置換複素環式基置換オキシ基、置換もしくは非置換低級 アルキルチオ基、置換もしくは非置換アリールチオ基、 置換もしくは非置換低級アルキル基、置換もしくは非置 換アミノ基、置換もしくは非置換複素環式基、置換もし くは非置換アリール基、シアノ基又はハロゲン原子、R ²は、式:-COOR³又は式:-CON(R⁴)(R⁵) で示される基、R3が水素原子またはエステル残基、--N(R4)(R5)で示される基が置換もしくは非置換含 窒素複素環式基または置換もしくは非置換アミノ基を表 わす。) で示されるイソキノリン誘導体またはその薬理 的に許容しうる塩。

【請求項2】 環Aが、式:

で示されるベンゼン環であり、環Bが、式: 【化5】

$$B^1$$
 B^2

で示されるベンゼン環である請求項2記載の化合物。 【請求項4】 A¹が、(1)ヒドロキシ低級アルキル 基置換ピリジル基、ピリジル基、N-オキソピリジル 基、ピラジニル基、ピリミジニル基、モルホリニル基、 ピペリジニル基、低級アルキル基置換ピロリジニル基、 ピロリジニル基、ピペラジニル基、低級アルコキシ基、 ジ低級アルキルアミノ基及びフェニル基から選ばれる基 で置換されていてもよい低級アルコキシ基、(2)ピリ ジル基置換低級アルケニル基または(3)ピリジル基置 換低級アルキル基であり、B1、B2及びB3が、同一ま たは異なって、低級アルコキシ基であり、R1が、

(1) 水酸基; カルボキシル基; 低級アルコキシ基; シ クロ低級アルキル基;低級アルキル基で置換されていて もよいピリジル基; ピリミジニル基; ピペラジニル基; ピペリジニル基;モルホリニル基;シアノ基;低級アル コキシ基で1~2個置換されていてもよいフェニル基; 低級アルコキシカルボニル基;カルバモイル基;ジ低級 アルキルカルバモイル基; 低級アルキルピリジル基置換 低級アルキルカルバモイル基;モルホリニルカルボニル 基:アミノ基:及びジ低級アルキルアミノ基から選ばれ る基で置換されていてもよい低級アルコキシ基、(2)

シクロ低級アルキルオキシ基、(3)低級アルケニルオ キシ基、(4)低級アルキニルオキシ基、(5)ジ低級 アルコキシフェノキシ基、(6)低級アルコキシカルボ ニル基で置換されていてもよいピペリジニルオキシ基、 (7)フェニル基置換低級アルキルチオ基、(8)フェ ニルチオ基、(9)ピリジン環部分が低級アルキル基で 置換されていてもよいピリジルカルボニルアミノ基;低 級アルキル基部分がピリジル基、低級アルケニルオキシ 基もしくはハロゲン原子で置換されていてもよい低級ア ルキルカルボニルアミノ基:低級アルコキシカルボニル アミノ基;フェニル基部分が保護されていてもよいアミ ノ基で置換されていてもよいフェニルカルボニルアミノ 基;及びアミノ基から選ばれる基で置換されていてもよ い低級アルキル基、(10)低級アルコキシ基で1~3 個置換されていてもよいフェニル基;アミノ基部分が低 級アルコキシカルボニル基で置換されていてもよいアミ ノフェニル基:ジフルオロフェニル基:低級アルキル 基;ヒドロキシ低級アルキル基;フェニル基部分がハロ ゲン原子及び低級アルコキシ基で置換されたフェニル基 置換低級アルキル基;ピリジル基部分が低級アルキル基 で置換されていてもよいピリジル基置換低級アルキル 基;テトラヒドロフラニル基置換低級アルキル基;低級 アルコキシ基置換低級アルキル基;モルホリニル基置換 低級アルキル基: ピリミジニルアミノ基置換低級アルキ ル基: ジ低級アルキルカルバモイル基置換低級アルキル 基;低級アルコキシカルボニルアミノ基;低級アルコキ シカルボニル基: ピリジルカルボニル基: モルホリニル 基;及び低級アルキルピペラジニル基から選ばれる基で 1~2個置換されていてもよいアミノ基、(11)ピリ ジル基、(12) N-オキソピリジル基、(13) ピリ ミジニル基、(14)水酸基で置換されていてもよい低 級アルキル基; テトラヒドロピリミジニル基; 及びピリ ミジニル基から選ばれる基で置換されていてもよいピペ ラジニル基、(15)低級アルコキシ基置換低級アルキ ル基もしくはヒドロキシ低級アルキル基で置換されてい てもよいモルホリニル基、(16)イミダゾリル基、 (17) テトラゾリル基、(18) 水酸基、ヒドロキシ 低級アルキル基及び低級アルコキシカルボニル基から選 ばれる基で置換されていてもよいピペリジニル基、(1 9)水酸基置換オキサゼピニル基、(20)水酸基もし くは低級アルキルアミノ基で置換されていてもよいピロ リジニル基、(21)ピリドニル基、(22)トリ低級 アルコキシ基置換フェニル基、(23)シアノ基または (24)ハロゲン原子である請求項3記載の化合物。 【請求項5】 A¹が、ピリジル基、N-オキソピリジ ル基、ピリミジニル基及びフェニル基から選ばれる基で 置換された低級アルコキシ基であり、R¹が、(1)低 級アルキルピリジル基又はカルバモイル基で置換された 低級アルコキシ基、(2)低級アルキルピリジルカルボ

ニルアミノ基置換低級アルキル基、(3)フェニル基部

分がハロゲン原子及び低級アルコキシ基で置換されたフェニル基置換低級アルキル基:及びジ低級アルキルアミノ基置換低級アルキル基から選ばれる基で置換されたアミノ基、(4)ピリジル基、(5)Nーオキソピリジル基、(6)ピリミジニル基、(7)テトラヒドロピリミジニル基置換ピペラジニル基、(8)フェニル基置換低級アルキルチオ基または(9)トリ低級アルコキシフェニル基である請求項4記載の化合物。

【請求項6】 A¹が、ピリジル基またはフェニル基で置換された低級アルコキシ基であり、R¹が、(1)フェニル基部分がハロゲン原子及び低級アルコキシ基で置換されたフェニル基置換低級アルキル基;及びジ低級アルキルアミノ基置換低級アルキル基から選ばれる基で置換されたアミノ基、(2)ピリジル基、(3)Nーオキソピリジル基または(4)ピリミジニル基である請求項5記載の化合物。

【請求項7】 環Aが、同一または異なる1~4個の置 換基を有しているベンゼン環であり、環Bが、同一また は異なる1~4個の置換基を有していてもよいベンゼン 環であり、当該環A及び環B上の置換基が、(1)ホル ミル基で保護されていてもよい水酸基、(2)低級アル キレンジオキシ基、(3)ハロゲン原子、(4)ピペリ ジニル基; ピリジル基; イミダゾリル基; 低級アルキル 基置換ピペリジニル基;フリル基;モルホリニル基;テ トラヒドロフリル基:低級アルキル基及びオキソ基で置 換されたジヒドロピリジル基;ピペラジニル基;低級ア ルコキシカルボニル基置換ピペラジニル基:シクロ低級 アルキル基;フェニル基;低級アルキレンジオキシフェ ニル基;低級アルコキシカルボニル基;水酸基;水酸基 置換低級アルコキシ基;カルボキシル基;低級アルコキ シ基;保護されていてもよいアミノ基;カルバモイル 基;ジ低級アルキルアミノ基;ピリジルカルボニルオキ シ基;ピリジン環部分が低級アルキル基で置換されてい てもよいピリジルカルボニルアミノ基:低級アルキル基 部分がピリジル基、低級アルケニルオキシ基もしくはハ ロゲン原子で置換されていてもよい低級アルキルカルボ ニルアミノ基:低級アルコキシカルボニルアミノ基:フ ェニル基部分が保護されていてもよいアミノ基で置換さ れていてもよいフェニルカルボニルアミノ基から選ばれ る同一または異なる1~2個の基で置換されていてもよ い低級アルキル基、(5)ピペリジニル基;ピリジル 基;イミダゾリル基;低級アルキル基置換ピペリジニル 基;フリル基;モルホリニル基;テトラヒドロフリル 基;低級アルキル基及びオキソ基で置換されたジヒドロ ピリジル基; ピペラジニル基; 低級アルコキシカルボニ ル基置換ピペラジニル基;シクロ低級アルキル基;フェ ニル基:低級アルキレンジオキシフェニル基:低級アル コキシカルボニル基; 水酸基; 水酸基置換低級アルコキ シ基;カルボキシル基;低級アルコキシ基;保護されて いてもよいアミノ基:カルバモイル基:ジ低級アルキル

アミノ基; ピリジルカルボニルオキシ基; ピリジン環部 分が低級アルキル基で置換されていてもよいピリジルカ ルボニルアミノ基;低級アルキル基部分がピリジル基、 低級アルケニルオキシ基もしくはハロゲン原子で置換さ れていてもよい低級アルキルカルボニルアミノ基:低級 アルコキシカルボニルアミノ基;フェニル基部分が保護 されていてもよいアミノ基で置換されていてもよいフェ ニルカルボニルアミノ基から選ばれる同一または異なる 1~2個の基で置換されていてもよい低級アルケニル 基、(6)低級アルキルカルバモイルオキシ基、(7) ジ低級アルキルカルバモイルオキシ基又は(8)式:R 6-(CO)_n-O-で示される基〔R⁶が(i)ヒドロ キシ低級アルキル基、低級アルキル基、オキソ基及び低 級アルコキシカルボニル基から選ばれる同一または異な る1~4個の基で置換されていてもよい複素環式基であ って、当該複素環部分が、ピリジル基、ピリミジニル 基、ピラジニル基、ピペリジニル基、ピペラジニル基、 ピロリジニル基、イソキノリル基、キノリル基、テトラ ゾリル基、チエニル基、フリル基、モルホリニル基、ピ ロリル基、ベンズイミダゾリル基、イミダゾリル基、キ ナゾリル基及びフタラジニル基から選ばれる基である複 素環式基;ベンジルオキシカルボニル基、4-メトキシ ベンジルオキシカルボニル基、9-フルオレニルメチル オキシカルボニル基、tert-ブトキシカルボニル 基、2,2,2-トリクロロエチルオキシカルボニル基 及び低級アルカノイル基から選ばれる基で保護されてい てもよいアミノ基、低級アルキレンジオキシ基、カルボ キシル基、低級アルコキシカルボニル基、低級アルコキ シ基、スルファモイル基、カルバモイル基、ニトロ基、 フェニル基、ハロゲン原子、低級アルキルアミノ基、ジ 低級アルキルアミノ基、低級アルキルピペラジノカルボ ニル基、ヒドロキシ低級アルキル基及び低級アルキル基 から選ばれる同一または異なる1~4個の基で置換され ていてもよい、フェニル基又はナフチル基;シアノ基; カルボキシル基;低級アルキルアミノ基;ジ低級アルキ ルアミノ基: 低級アルコキシ基置換低級アルコキシ基; 低級アルコキシ基:水酸基:カルバモイル基:低級アル コキシカルボニル基;シクロ低級アルキル基;及びベン ゾイル基から選ばれる同一または異なる1~2個の基で 置換されていてもよい低級アルキル基、(ii)低級ア ルキル基、シアノ基、カルボキシル基、低級アルキルア ミノ基、ジ低級アルキルアミノ基、低級アルコキシ基置 換低級アルキル基、水酸基、低級アルコキシ基、カルバ モイル基、低級アルコキシカルボニル基及びニトロ基か ら選ばれる同一または異なる1~4個の基で置換されて いてもよい複素環式基であって、当該複素環部分が、ピ リジル基、ピリミジニル基、ピラジニル基、ピペリジニ ル基、ピペラジニル基、ピロリジニル基、イソキノリル 基、キノリル基、テトラゾリル基、チエニル基、フリル 基、モルホリニル基、ピロリル基、ベンズイミダゾリル

基、イミダゾリル基、キナゾリル基及びフタラジニル基 から選ばれる基である複素環式基、nがOまたは1〕、 R1が、(1)ピペリジニル基;低級アルキル基で置換 されていてもよいピリジル基;イミダゾリル基;ピリミ ジニル基: 低級アルキル基置換ピペリジニル基: フリル 基:モルホリニル基:テトラヒドロフリル基:低級アル キル基及びオキソ基で置換されたジヒドロピリジル基: ピペラジニル基;低級アルコキシカルボニル基置換ピペ ラジニル基;シクロ低級アルキル基;フェニル基;低級 アルキレンジオキシフェニル基;低級アルキル基で1~ 2個置換されたフェニル基;低級アルコキシカルボニル 基;水酸基;水酸基置換低級アルコキシ基;カルボキシ ル基;低級アルコキシ基;保護されていてもよいアミノ 基;ピリジルカルボニルオキシ基;シアノ基;カルバモ イル基; ジ低級アルキルカルバモイル基; 低級アルキル 基置換ピリジル低級アルキルカルバモイル基:モルホリ ニルカルボニル基;アミノ基;ジ低級アルキルアミノ 基:及びカルボキシルアミノ基から選ばれる同一または 異なる1~3個の基で置換されていてもよい低級アルコ キシ基、(2)低級アルコキシカルボニル基、水酸基、 カルボキシル基、低級アルキル基、低級アルコキシ基、 ヒドロキシ低級アルキル基及び保護されていてもよいア ミノ基から選ばれる同一または異なる1~3個の基で置 換されていてもよいシクロ低級アルキルオキシ基、

(3) ピペリジニル基; ピリジル基; イミダゾリル基; 低級アルキル基置換ピペリジニル基;フリル基;モルホ リニル基;テトラヒドロフリル基;低級アルキル基及び オキソ基で置換されたジヒドロピリジル基:ピペラジニ ル基; 低級アルコキシカルボニル基置換ピペラジニル 基;シクロ低級アルキル基;フェニル基;低級アルキレ ンジオキシフェニル基;低級アルコキシカルボニル基; 水酸基;水酸基置換低級アルコキシ基;カルボキシル 基;低級アルコキシ基;保護されていてもよいアミノ 基;カルバモイル基;ジ低級アルキルアミノ基;ピリジ ルカルボニルオキシ基; ピリジン環部分が低級アルキル 基で置換されていてもよいピリジルカルボニルアミノ 基: 低級アルキル基部分がピリジル基、低級アルケニル オキシ基もしくはハロゲン原子で置換されていてもよい 低級アルキルカルボニルアミノ基: 低級アルコキシカル ボニルアミノ基;及びフェニル基部分が保護されていて もよいアミノ基で置換されていてもよいフェニルカルボ ニルアミノ基から選ばれる同一または異なる1~2個の 基で置換されていてもよい低級アルケニルオキシ基、

(4)ピペリジニル基;ピリジル基;イミダゾリル基; 低級アルキル基置換ピペリジニル基;フリル基;モルホ リニル基;テトラヒドロフリル基;低級アルキル基及び オキソ基で置換されたジヒドロピリジル基;ピペラジニ ル基;低級アルコキシカルボニル基置換ピペラジニル 基;シクロ低級アルキル基;フェニル基;低級アルキレ ンジオキシフェニル基;低級アルコキシカルボニル基;

基;低級アルコキシ基;保護されていてもよいアミノ 基;カルバモイル基;ジ低級アルキルアミノ基;ピリジ ルカルボニルオキシ基;ピリジン環部分が低級アルキル 基で置換されていてもよいピリジルカルボニルアミノ 基;低級アルキル基部分がピリジル基、低級アルケニル オキシ基もしくはハロゲン原子で置換されていてもよい 低級アルキルカルボニルアミノ基; 低級アルコキシカル ボニルアミノ基;及びフェニル基部分が保護されていて もよいアミノ基で置換されていてもよいフェニルカルボ ニルアミノ基から選ばれる同一または異なる1~2個の 基で置換されていてもよい低級アルキニルオキシ基、 (5) ハロゲン原子、低級アルキルアミノ基、ジ低級ア ルキルアミノ基、モルホリノ基、低級アルキル基置換ピ リミジニル基、低級アルキル基置換ピラゾリル基、ヒド ロキシ低級アルキル基、保護されていてもよいアミノ 基、低級アルカノイル基置換アミノ基、低級アルコキシ 基、低級アルキル基、保護されていてもよい水酸基、カ ルボキシル基置換低級アルキル基、低級アルコキシカル ボニル基置換低級アルキル基、低級アルコキシカルボニ ル基置換低級アルコキシ基、カルバモイル基、カルボキ シル基、低級アルキルチオ基、低級アルコキシカルボニ ル基、ニトロ基、トリハロゲノ低級アルキル基、モルホ リノカルボニル基、カルボキシル基置換低級アルコキシ 基、ジ(低級アルキルスルホニル)アミノ基、モルホリ ノ低級アルキルカルバモイル基置換低級アルコキシ基、 スルファモイル基、保護されていてもよいアミノ基で置 換された低級アルキル基、低級アルキル基及びアミノ基 の保護基で置換されたアミノ基、低級アルキレンジオキ シ基、保護されていてもよいアミノ基で置換されたカル バモイル基、低級アルキルスルフィニル基及び低級アル キルスルホニル基から選ばれる同一または異なる1~4 個の基で置換されていてもよいナフチルオキシ基または フェニルオキシ基、(6)水酸基、ハロゲン原子、低級 アルキル基、フェニル基置換低級アルキル基、低級アル コキシ基置換低級アルキル基、ヒドロキシ低級アルキル 基、テトラヒドロピリミジニル基、ピリミジニル基、オ キソ基、低級アルコキシ基、保護されていてもよいアミ ノ基、低級アルキルアミノ基、ジ低級アルキルアミノ 基、フェニル低級アルコキシカルボニル基、低級アルコ キシカルボニル基、カルボキシル基及びカルバモイル基 から選ばれる同一または異なる1~4個の基で置換され ていてもよい複素環式基置換オキシ基、(7)ピペリジ ニル基;低級アルキル基で置換されていてもよいピリジ ル基;イミダゾリル基;ピリミジニル基;低級アルキル 基置換ピペリジニル基;フリル基;モルホリニル基;テ トラヒドロフリル基;低級アルキル基及びオキソ基で置 換されたジヒドロピリジル基;ピペラジニル基;低級ア ルコキシカルボニル基置換ピペラジニル基;シクロ低級 アルキル基:フェニル基:低級アルキレンジオキシフェ

水酸基;水酸基置換低級アルコキシ基;カルボキシル

ニル基;低級アルキル基で1~2個置換されたフェニル 基;低級アルコキシカルボニル基;水酸基;水酸基置換 低級アルコキシ基;カルボキシル基;低級アルコキシ 基;保護されていてもよいアミノ基;ピリジルカルボニ ルオキシ基;シアノ基;カルバモイル基;ジ低級アルキ ルカルバモイル基: 低級アルキル基置換ピリジル低級ア ルキルカルバモイル基;モルホリニルカルボニル基;ア ミノ基: ジ低級アルキルアミノ基; 及びカルボキシルア ミノ基から選ばれる同一または異なる1~3個の基で置 換されていてもよいアルキルチオ基、(8)ハロゲン原 子、低級アルキルアミノ基、ジ低級アルキルアミノ基、 モルホリノ基、低級アルキル基置換ピリミジニル基、低 級アルキル基置換ピラゾリル基、ヒドロキシ低級アルキ ル基、保護されていてもよいアミノ基、低級アルカノイ ル基置換アミノ基、低級アルコキシ基、低級アルキル 基、保護されていてもよい水酸基、カルボキシル基置換 低級アルキル基、低級アルコキシカルボニル基置換低級 アルキル基、低級アルコキシカルボニル基置換低級アル コキシ基、カルバモイル基、カルボキシル基、低級アル キルチオ基、低級アルコキシカルボニル基。ニトロ基。 トリハロゲノ低級アルキル基、モルホリノカルボニル 基、カルボキシル基置換低級アルコキシ基、ジ(低級ア ルキルスルホニル) アミノ基、モルホリノ低級アルキル カルバモイル基置換低級アルコキシ基、スルファモイル 基、保護されていてもよいアミノ基で置換された低級ア ルキル基、低級アルキル基及びアミノ基の保護基で置換 されたアミノ基、低級アルキレンジオキシ基、保護され ていてもよいアミノ基で置換されたカルバモイル基、低 級アルキルスルフィニル基及び低級アルキルスルホニル 基から選ばれる同一または異なる1~4個の基で置換さ れていてもよいナフチルチオ基またはフェニルチオ基、 (9) ピペリジニル基; ピリジル基; イミダゾリル基; 低級アルキル基置換ピペリジニル基;フリル基;モルホ リニル基:テトラヒドロフリル基:低級アルキル基及び オキソ基で置換されたジヒドロピリジル基;ピペラジニ ル基; 低級アルコキシカルボニル基置換ピペラジニル 基;シクロ低級アルキル基;フェニル基;低級アルキレ ンジオキシフェニル基;低級アルコキシカルボニル基; 水酸基:水酸基置換低級アルコキシ基;カルボキシル 基;低級アルコキシ基;保護されていてもよいアミノ 基:カルバモイル基;ジ低級アルキルアミノ基:ピリジ ルカルボニルオキシ基; ピリジン環部分が低級アルキル 基で置換されていてもよいピリジルカルボニルアミノ 基:低級アルキル基部分がピリジル基、低級アルケニル オキシ基もしくはハロゲン原子で置換されていてもよい 低級アルキルカルボニルアミノ基; 低級アルコキシカル ボニルアミノ基;及びフェニル基部分が保護されていて もよいアミノ基で置換されていてもよいフェニルカルボ ニルアミノ基から選ばれる同一または異なる1~3個の 基で置換されていてもよい低級アルキル基、(10)ア

ミノ基の保護基;ピリジル基;低級アルカノイル基;低 級アルキル基; ヒドロキシ低級アルキル基; フェニル 基;低級アルカノイルオキシ基置換低級アルキル基;ト リハロゲノ低級アルカノイル基;低級アルコキシ基で1 ~3個置換されていてもよいフェニル基;フェニル基部 分がハロゲン原子及び低級アルコキシ基で置換されたフ ェニル基置換低級アルキル基;ジ低級アルキルアミノ基 置換低級アルキル基; ピリジル基置換低級アルキル基; テトラヒドロフラニル基置換低級アルキル基;低級アル コキシ基置換低級アルキル基; モルホリニル基置換低級 アルキル基:ピリミジニルアミノ基置換低級アルキル 基; ジ低級アルキルカルバモイル基置換低級アルキル 基; ジ低級アルキルアミノ基置換低級アルキル基; シク ロ低級アルキル基;低級アルコキシフェニル基;低級ア ルコキシカルボニルアミノ基;モルホリニル基;及び低 級アルキルピペラジニル基から選ばれる同一または異な る1~2個の基で置換されていてもよいアミノ基、(1 1)水酸基、ハロゲン原子、低級アルキル基、フェニル 基置換低級アルキル基、低級アルコキシ基置換低級アル キル基、ヒドロキシ低級アルキル基、テトラヒドロピリ ミジニル基、ピリミジニル基、オキソ基、低級アルコキ シ基、保護されていてもよいアミノ基、低級アルキルア ミノ基、ジ低級アルキルアミノ基、フェニル低級アルコ キシカルボニル基、低級アルコキシカルボニル基、カル ボキシル基及びカルバモイル基から選ばれる同一または 異なる1~4個の基で置換されていてもよい複素環式基 であり、当該複素環部分が、ピラニル基、インダゾリル 基、ベンゾトリアゾリル基、ピロリル基、イミダゾリル 基、フリル基、チエニル基、チアゾリル基、イソオキサ ゾリル基、オキサゾリル基、オキサゾリニル基、オキサ ゼピニル基、ピラゾリル基、フタラジニル基、キナゾリ ニル基、チエノピリミジニル基、ピリジル基、ピリミジ ニル基、ピリダジニル基、ピラジニル基、トリアジニル 基、テトラゾリル基、キノリル基、イソキノリル基、キ ノキサリニル基、インドリル基、ベンゾチエニル基、ベ ンゾチアゾリル基、ベンゾオキサゾリル基またはベンズ イミダゾリル基、ピペラジニル基、ピロリジニル基、ピ ペリジニル基、ピラゾリジニル基、キヌクリジニル基、 チオモルホリニル基、モルホリニル基、ヘキサヒドロピ リミジニル基、テトラヒドロフラニル基、テトラヒドロ ピラジニル基及びジオキサニル基から選ばれる複素環式 基、(12)ハロゲン原子、低級アルキルアミノ基、ジ 低級アルキルアミノ基、モルホリノ基、低級アルキル基 置換ピリミジニル基、低級アルキル基置換ピラゾリル 基、ヒドロキシ低級アルキル基、保護されていてもよい アミノ基、低級アルカノイル基置換アミノ基、低級アル コキシ基、低級アルキル基、保護されていてもよい水酸 基、カルボキシル基置換低級アルキル基、低級アルコキ シカルボニル基置換低級アルキル基、低級アルコキシカ ルボニル基置換低級アルコキシ基、カルバモイル基、カ

ルボキシル基、低級アルキルチオ基、低級アルコキシカ ルボニル基、ニトロ基、トリハロゲノ低級アルキル基、 モルホリノカルボニル基、カルボキシル基置換低級アル コキシ基、ジ(低級アルキルスルホニル)アミノ基、モ ルホリノ低級アルキルカルバモイル基置換低級アルコキ シ基、スルファモイル基、保護されていてもよいアミノ 基で置換された低級アルキル基、低級アルキル基及びア ミノ基の保護基で置換されたアミノ基、低級アルキレン ジオキシ基、保護されていてもよいアミノ基で置換され たカルバモイル基、低級アルキルスルフィニル基及び低 級アルキルスルホニル基から選ばれる同一または異なる 1~4個の基で置換されていてもよい、フェニル基また はナフチル基、(13)シアノ基又は(14)ハロゲン 原子、R²が式:-COOR³又は式:-CON(R⁴) (R5)で示される基、R3が水素原子、低級アルキル 基、トリ低級アルキルシリル低級アルキル基またはフェ ニル低級アルキル基、-N(R4)(R5)で示される基 がヒドロキシ低級アルキル基置換ピペラジニル基;モル ホリノ基: ピロリジニル基: 低級アルキル基部分がイミ ダゾリル基、シクロ低級アルキル基、低級アルキルピリ ジル基及び水酸基から選ばれる基で置換されていてもよ い低級アルキルアミノ基:低級アルキル基部分が水酸基 で置換されていてもよいジ低級アルキルアミノ基;また はアミノ基である請求項1記載の化合物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は医薬として有用なc GMP特異的ホスホジエステラーゼ(PDE)阻害作用 [PDE V阻害作用]を有する新規イソキノリン誘導 体に関する。

[0002]

【従来の技術】一般に、細胞内セカンドメッセンジャーであるcGMPは、生体内の組織に広く分布するホスホジエステラーゼ(PDE)により分解され不活性化されるが、該PDE活性を阻害すると、細胞内のcGMPの濃度が上昇し、その結果、種々の薬理作用、例えば、血管平滑筋弛緩作用、気管支平滑筋弛緩作用等が発現することが知られている。また、このようなcGMP特異的PDE阻害薬(即ち、PDE V阻害薬)は、血小板凝集抑制作用、血管拡張作用等を示す〔C.D.Nicholsonら,トレンズ・イン・ファーマコロジカル・サイエンシーズ,第12巻,第19頁(1991年)(Trends in Pharmacological Sciences)〕ことが知られている。【0003】したがって、PDE V阻害薬は、気管支

【0003】したがって、PDE V阻害薬は、気管支喘息、血栓症、うつ病、脳血管閉塞後の中枢機能低下症、脳血管痴呆症及び心不全などの治療薬として有用であると考えられている。

【0004】また、近年上記のようなPDE V阻害作用を有する縮合ピリダジン系化合物等が、高血圧症、狭

心症、心筋梗塞、慢性及び急性心不全、肺高血圧症等の 予防・治療に有用であること(特開平8-225541 号等)及びPDE V阻害作用を有するイソキノリノン 誘導体が、慢性心不全、狭心症、肺高血圧症、陰茎勃起 不全等の予防・治療に有用であること(WO98/38 168)が知られている。

【0005】更に、PDE V阻害作用を有する1-〔4-エトキシ-3-(6,7-ジヒドロ-1-メチル -d]ピリミジン-5-イル)フェニルスルホニル]-4-メチルピペラジン〔一般名;シルデナフィル(SI LDENAFIL) 〕が陰茎勃起不全等の疾患の治療に 有用であることも報告されている〔Boolell M ら, ザ・ジャーナル・オブ・ウロロジー サプリメン ト, 第155巻, 第5号, 第495A頁739 (199 6年) (The Journal of Urolog y, Supplyment), Terrett N K ら,バイオオルガニック・アンド・メディシナル・ケミ ストリー・レターズ, 第6巻, 第15号, 第1819頁 (1996年) (Bioorganic & Medi cinal Chemistry Letters)及 びBallard S Aら, ブリティシュ・ジャーナ ル・オブ・ファーマコロジー プロシーディング・サプ リメント, 第118巻, 153P(1996年)(Br itish Journal of Pharmaco logy, Proceeding Supplymen t)〕。しかしながら、シルデナフィルには、頭痛、顔 面紅潮、消化管障害、鼻炎、色覚異常〔Irwin G ら, ザ・ニュー・イングラド・ジャーナル・オブ・メデ ィシン, 第338巻, 第20号, 第1397-1404 頁(1998年)(The New England Journal of Medicine), A Mo ralesら、インターナショナル・ジャーナル・オブ ・インポテンス・リサーチ、第10巻、第2号、第69 -73頁(1998年) (International Journal of Impotence Res earch) 及びGoldenberg M M, クリ ニカル・セラピューティクス、第20巻、第6号、第1 033-1048頁(1998年)(Clinical Therapeutics)〕及び勃起持続症〔ht tp://www.fda.gov/bbs/topi cs/ANSWERS/ANS00926. html) 等の副作用があることも報告されている。また、イヌの 実験において、シルデナフィルは網膜組織の光応答の影 響に関してPDE VI阻害作用と相関していることが 報告〔AMoralesら、インターナショナル・ジャ ーナル・オブ・インポテンス・リサーチ,第10巻,第 2号, 第69-73頁(1998年) (Interna tional Journal of Impoten ce Research) 〕されており、一方、網膜の

PDE VIが視覚機能において重要な役割を奏していることも報告 [A Morales6, インターナショナル・ジャーナル・オブ・インポテンス・リサーチ、第10巻、第2号、第69-73頁(1998年)(International Journal of Impotence Research)及びM Estrade6, ヨーロピアン・ジャーナル・オブ・ファーマコロジー、第352巻、第157-163頁(1998年)(European Journal of Pharmacology)〕されている。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、優れたホスホジエステラーゼV(PDE V)阻害作用を有する新規イソキノリン誘導体を提供するものである。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明は、一般式 [I] 【0008】

【化6】

【0009】 (式中、環Aは、置換されたベンゼン環、 環Bは、置換もしくは非置換ベンゼン環、R1は、置換 もしくは非置換低級アルコキシ基、置換もしくは非置換 シクロ低級アルキルオキシ基、置換もしくは非置換低級 アルケニルオキシ基、置換もしくは非置換低級アルキニ ルオキシ基、置換もしくは非置換アリールオキシ基、置 換もしくは非置換複素環式基置換オキシ基、置換もしく は非置換低級アルキルチオ基、置換もしくは非置換アリ ールチオ基、置換もしくは非置換低級アルキル基、置換 もしくは非置換アミノ基、置換もしくは非置換複素環式 基、置換もしくは非置換アリール基、シアノ基又はハロ ゲン原子、R²は、式:-COOR³又は式:-CON (R4)(R5)で示される基、R3が水素原子またはエ ステル残基、-N(R4)(R5)で示される基が置換も しくは非置換含窒素複素環式基または置換もしくは非置 換アミノ基を表わす。) で示されるイソキノリン誘導体 またはその薬理的に許容しうる塩に関する。

[0010]

【発明の実施の形態】本発明の目的化合物〔I〕におけるR²が式:-COOR³で示される基の場合、R³としては水素原子またはベンジル基、ニトロベンジル基、保護されていてもよいアミノベンジル基、低級アルコキシベンジル基等のアリール低級アルキル基、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基等の低級アルキル基、シクロペンチル基等のシクロ低級アルキル基、あるいはトリメチルシリルメチル基、tert-ブチルジメチルシ

リルメチル基等のトリ低級アルキルシリル低級アルキル基の如きエステル残基が挙げられる。このうち、R³が低級アルキル基、即ち、R²が低級アルコキシカルボニル基であるものが好ましい。また、R²が式:-CON(R⁴)(R⁵)で示される基である場合、-N(R⁴)(R⁵)で示される基としては、例えば、ヒドロキシ低級アルキル基置換ピペラジノ基、モルホリノ基、ピロリジノ基、サペリジノ基の如き置換もしくは非置換含窒素5~6員脂肪族複素環式基、または低級アルキル基部分がイミダゾリル基、シクロ低級アルキル基、低級アルキルピリジル基及び水酸基から選ばれる基で置換されていてもよい低級アルキルアミノ基、低級アルキルアミノ基、アミノ基の如き置換もしくは非置換アミノ基が挙げられる。

【OO11】本発明の化合物 (I) の環Aとしては、同一または異なる $1\sim4$ 個の置換基を有しているベンゼン環が挙げられ、当該置換基としては、保護されていてもよい水酸基、低級アルキレンジオキシ基、ハロゲン原子、置換もしくは非置換低級アルキルカルバモイルオキシ基、ジ低級アルキルカルバモイルオキシ基、ジ低級アルキルカルバモイルオキシ基または式: $R^6-(CO)_n-O-$ で示される基(R^6 は置換もしくは非置換低級アルキル基、置換もしくは非置換低級アルケニル基、置換もしくは非置換がアルケニル基、置換もしくは非置換シクロ低級アルキル基、置換もしくは非置換アリールスルホニル基または置換もしくは非置換アリールスルホニル基または置換もしくは非置換複素環式基であり、n はO または1)が挙げられる。

【0012】本発明の化合物〔I〕の環Bとしては、同 一または異なる1~4個の置換基を有していてもよいべ ンゼン環が挙げられ、当該置換基としては、保護されて いてもよい水酸基、低級アルキレンジオキシ基、ハロゲ ン原子、置換もしくは非置換低級アルキル基、置換もし くは非置換低級アルケニル基、低級アルキルカルバモイ ルオキシ基、ジ低級アルキルカルバモイルオキシ基また は式: R⁶- (CO)_n-O-で示される基(R⁶は置換 もしくは非置換低級アルキル基、置換もしくは非置換低 級アルケニル基、置換もしくは非置換シクロ低級アルキ ル基、置換もしくは非置換アリール基、置換もしくは非 置換アリールスルホニル基または置換もしくは非置換複 素環式基であり、nはOまたは1)が挙げられる。環B のより好ましい例としては、同一または異なる1~4個 の置換基を有していてもよいベンゼン環が挙げられ、当 該置換基としては、保護されていてもよい水酸基、低級 アルコキシ基、低級アルキル基、ハロゲン原子または低 級アルキレンジオキシ基が挙げられる。

【0013】本発明の目的化合物〔I〕の環A及び/又は環Bが置換低級アルキル基を有する場合、低級アルキル基上の置換基としては、例えば、ピペリジニル基;ピリジル基;イミダゾリル基;低級アルキル基置換ピペリ

ジニル基;フリル基;モルホリニル基;テトラヒドロフ リル基;低級アルキル基及びオキソ基で置換されたジヒ ドロピリジル基;ピペラジニル基;低級アルコキシカル ボニル基置換ピペラジニル基;シクロ低級アルキル基; フェニル基;低級アルキレンジオキシフェニル基;低級 アルコキシカルボニル基:水酸基:水酸基置換低級アル コキシ基;カルボキシル基;低級アルコキシ基;保護さ れていてもよいアミノ基;カルバモイル基;ジ低級アル キルアミノ基;ピリジルカルボニルオキシ基;ピリジン 環部分が低級アルキル基で置換されていてもよいピリジ ルカルボニルアミノ基;低級アルキル基部分がピリジル 基、低級アルケニルオキシ基もしくはハロゲン原子で置 換されていてもよい低級アルキルカルボニルアミノ基: 低級アルコキシカルボニルアミノ基; フェニル基部分が 保護されていてもよいアミノ基で置換されていてもよい フェニルカルボニルアミノ基等が挙げられる。これら置 換基は低級アルキル基上に、同一または異なって1~2 個置換していてもよい。

【0014】本発明の目的化合物〔Ⅰ〕の環A及び/又 は環Bが置換低級アルケニル基を有する場合、低級アル ケニル基上の置換基としては、例えば、ピペリジニル 基;ピリジル基;イミダゾリル基;低級アルキル基置換 ピペリジニル基;フリル基;モルホリニル基;テトラヒ ドロフリル基: 低級アルキル基及びオキソ基で置換され たジヒドロピリジル基; ピペラジニル基; 低級アルコキ シカルボニル基置換ピペラジニル基:シクロ低級アルキ ル基;フェニル基;低級アルキレンジオキシフェニル 基:低級アルコキシカルボニル基:水酸基:水酸基置換 低級アルコキシ基; カルボキシル基; 低級アルコキシ 基:保護されていてもよいアミノ基:カルバモイル基: ジ低級アルキルアミノ基; ピリジルカルボニルオキシ 基; ピリジン環部分が低級アルキル基で置換されていて もよいピリジルカルボニルアミノ基; 低級アルキル基部 分がピリジル基、低級アルケニルオキシ基もしくはハロ ゲン原子で置換されていてもよい低級アルキルカルボニ ルアミノ基;低級アルコキシカルボニルアミノ基;フェ ニル基部分が保護されていてもよいアミノ基で置換され ていてもよいフェニルカルボニルアミノ基等が挙げられ る。これら置換基は低級アルケニル基上に、同一または 異なって1~2個置換していてもよい。

【0015】環A及び/または環Bが、式: R⁶-(CO)_n-O-で示される置換基を有する場合、かかる基R⁶の具体例としては、(1)ヒドロキシ低級アルキル基、低級アルキル基、オキソ基及び低級アルコキシカルボニル基から選ばれる同一または異なる1~4個の基で置換されていてもよい5~10員単環もしくは二環式複素環式基;低級アルキレンジオキシ基、カルボキシル基、低級アルコキシカルボニル基、低級アルコキシ基、スルファモイル基、カルバモイル基、ニトロ基、保護されていてもよいアミノ基、フェニル基、ハロゲン原子、

低級アルキルアミノ基、ジ低級アルキルアミノ基、低級 アルキルピペラジノカルボニル基、ヒドロキシ低級アル キル基及び低級アルキル基から選ばれる同一または異な る1~4個の基で置換されていてもよい6~10員単環 式もしくは二環式アリール基:シアノ基:カルボキシル 基;低級アルキルアミノ基;ジ低級アルキルアミノ基; 低級アルコキシ基置換低級アルコキシ基; 低級アルコキ シ基:水酸基:カルバモイル基:低級アルコキシカルボ ニル基;シクロ低級アルキル基;及びベンゾイル基から 選ばれる同一または異なる1~2個の基で置換されてい てもよい低級アルキル基、または(2)低級アルキル 基、シアノ基、カルボキシル基、低級アルキルアミノ 基、ジ低級アルキルアミノ基、低級アルコキシ基置換低 級アルキル基、水酸基、低級アルコキシ基、カルバモイ ル基、低級アルコキシカルボニル基及びニトロ基から選 ばれる同一または異なる1~4個の基で置換されていて もよい5~10員単環もしくは二環式複素環式基が挙げ られる。

【0016】また当該6~10員単環式もしくは二環式アリール基としては、例えば、フェニル基、ナフチル基等が挙げられ、5~10員単環もしくは二環式複素環式基としては、ピリジル基、ピリミジニル基、ピラジニル基、ピペリジニル基、ピペラジニル基、ピロリジニル基、イソキノリル基、キノリル基、テトラゾリル基、チエニル基、フリル基、モルホリニル基、ピロリル基、ベンズイミダゾリル基、イミダゾリル基、キナゾリル基、フタラジニル基等が挙げられる。

【0017】本発明の化合物における環A及び環Bの好ましい例としては、例えば、環Aが式:

[0018]

【化7】

A¹ thu A²

A¹ A¹ stu

【0024】で示されるベンゼン環、環Bが、式:

[0025]

【化10】

$$B^1$$
 B^3 B^3

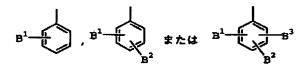
【0026】で示されるベンゼン環であるものが挙げられる。

【0027】また、環A及び環Bのうち、更に好ましい例としては、例えば、環Aが式:

【0019】で示されるベンゼン環であり、環Bが、式:

[0020]

【化8】



【〇〇21】で示されるベンゼン環であり、A¹が保護 されていてもよい水酸基、ハロゲン原子、置換もしくは 非置換低級アルキル基、置換もしくは非置換低級アルケ ニル基、低級アルキルカルバモイルオキシ基、ジ低級ア ルキルカルバモイルオキシ基及び式: R6-(CO),-〇一で示される基から選ばれる基、A2が保護されてい てもよい水酸基、ハロゲン原子、置換もしくは非置換低 級アルキル基、置換もしくは非置換低級アルケニル基、 低級アルキルカルバモイルオキシ基、ジ低級アルキルカ ルバモイルオキシ基及び式:R⁶-(CO),-O-で示 される基から選ばれる基であるか、またはA1及びA2が 互いに末端で結合して低級アルキレンジオキシ基を形成 し、 B^1 、 B^2 及び B^3 が、同一または異なって、保護さ れていてもよい水酸基、低級アルコキシ基、低級アルキ ル基またはハロゲン原子であるか、あるいは、いずれか 2つが互いに末端で結合して低級アルキレンジオキシ基 を形成するものが挙げられる。

【0022】上記の環A及び環Bのうち、より好ましい例としては、例えば、環Aが式:

[0023]

【化9】

stu ()

【0028】 【化11】

【0029】で示されるベンゼン環、環Bが、式:

[0030]

【化12】

$$\mathbb{B}^1$$
 \mathbb{B}^3

【0031】で示されるベンゼン環であるものが挙げられる。

【0032】一方、環A及び環Bのうち、他に好ましい例としては、例えば、環Aが式:

[0033]

【化13】

【0034】で示されるベンゼン環、環Bが、式:

[0035]

【化14】

【0036】で示されるベンゼン環であるものが挙げられる。

【0037】上記の環A上の置換基(A1及びA2)の具 体例としては、保護されていてもよい水酸基; 低級アル キレンジオキシフェニル基、ベンズイミダゾリル基、低 級アルキル基置換イミダゾリル基、シアノ基、カルボキ シル基、ピリジル基、Nーオキソピリジル基、ヒドロキ シ低級アルキル基置換ピリジル基、低級アルキル基置換 ピロリジニル基、ピロリジニル基、イソキノリル基、低 級アルキル基置換ピリミジニル基、ピリミジニル基、ピ ラジニル基、キナゾリル基、フタラジニル基、低級アル コキシカルボニル基置換ピペリジニル基、ピペリジニル 基、キノリル基、ピペラジニル基、テトラゾリル基、モ ルホリニル基、チエニル基、フリル基、低級アルキル基 及び低級アルコキシカルボニル基で置換されたピロリル 基、低級アルキルアミノ基、ジ低級アルキルアミノ基、 低級アルコキシ基置換低級アルコキシ基、低級アルコキ シ基、水酸基、カルバモイル基、低級アルコキシカルボ ニル基、シクロ低級アルキル基、フェニル基、ヒドロキ シ低級アルキル基で置換されたフェニル基、カルボキシ ル基置換フェニル基、低級アルコキシカルボニル基置換 フェニル基、ベンゾイル基、低級アルキルアミノ基、ジ 低級アルコキシ基置換フェニル基、ニトロ基置換フェニ ル基、ナフチル基、モノもしくはジハロゲノフェニル 基、カルバモイル基置換フェニル基、スルファモイル基 置換フェニル基、保護されていてもよいアミノ基でモノ もしくはジ置換されたフェニル基、ビフェニル基、ハロ ゲン原子及びニトロ基でジ置換されたフェニル基、ジ低

級アルキルアミノ基置換フェニル基及び低級アルキル基置換フェニル基から選ばれる基で置換されていてもよい低級アルコキシ基;低級アルキレンジオキシ基;ハロゲン原子;ピリジル基で置換された低級アルキル基;ピリジル基で置換された低級アルケニル基;シクロ低級アルキルオキシ基;ピリジルオキシ基;低級アルケニルオキシ基;モルホリノカルボニルオキシ基;低級アルキル基置換ピペラジニルカルボニルオキシ基;低級アルキル基及びニトロ基で置換されたピロリルカルボニルオキシ基;ピロリルカルボニルオキシ基;低級アルキルカルバモイルオキシ基;近級アルキルカルバモイルオキシ基;近級アルキルメルカルバモイルオキシ基;近級アルキル基置換フェニルスルホニルオキシ基;またはベンゾイルオキシ基等が挙げられる。

【0038】本発明化合物〔I〕のR¹が置換もしくは非置換アリール基、置換もしくは非置換アリールオキシ基または置換もしくは非置換アリールチオ基である場合、当該アリール基としては、一部が飽和していてもよい単環、二環もしくは三環式の6~14員アリール基が挙げられる。単環式アリール基としてはフェニル基、シクロへキサジエニル基、シクロへキセニル基等が挙げられる。二環式アリール基としてはナフチル基、インデニル基、インダニル基、アズレニル基等が挙げられる。また、三環式アリール基としてはフルオレニル基、フェナントレニル基、アントラセニル基等が挙げられる。

【0039】本発明の目的化合物〔I〕におけるR¹が 置換もしくは非置換複素環式基または置換もしくは非置 換複素環式基オキシ基である場合、当該複素環式基とし ては、一部が飽和していてもよい単環式または二環式の 5~12員の複素環式基が挙げられ、具体的には、単環 式または二環式の5~12員芳香族複素環式基あるいは 単環もしくは二環式の5~12員脂肪族複素環式基が挙 げられる。

【0040】単環式または二環式の5~12員芳香族複素環式基としては、窒素原子、酸素原子及び硫黄原子から選ばれる1~4個の異項原子を含む単環もしくは二環式の5~10員芳香族複素環式基であるものが好ましく、例えば、ピラニル基、インダゾリル基、ベンゾトリアゾリル基、ピロリル基、イミダゾリル基、フリル基、チエニル基、チアゾリル基、イソオキサゾリル基、オキサゾリル基、オキサゾリル基、オキサビピニル基、ピラゾリル基、フタラジニル基、ピリミジニル基、ピリジレル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基、ピラジニル基、トリアジニル基、テトラゾリル基、キノリル基、インドリル基、インドチエニル基、ベンゾチアゾリル基、ベンゾオキサゾリル基またはベンズイミダゾリル基等が挙げられる。

【0041】単環もしくは二環式の5~12員の脂肪族 複素環式基としては、窒素原子、酸素原子及び硫黄原子 から選ばれる1~4個の異項原子を含む単環式5~10 員脂肪族複素環式基であるものが好ましく、例えばピペラジニル基、ピロリジニル基、ピペリジニル基、ピラゾリジニル基、キヌクリジニル基、チオモルホリニル基、モルホリニル基、ヘキサヒドロピリミジニル基、テトラヒドロフラニル基、テトラヒドロピラジニル基またはジオキサニル基等が挙げられる。

【0042】これら複素環式基のうち、異項原子として 窒素原子を少なくとも1つ含む含窒素複素環式基が好ま しい。

【0043】本発明の目的化合物〔I〕におけるR1が 置換低級アルコキシ基である場合、低級アルコキシ基上 の置換基としては、例えば、ピペリジニル基: 低級アル キル基で置換されていてもよいピリジル基;イミダゾリ ル基; ピリミジニル基; 低級アルキル基置換ピペリジニ ル基; フリル基; モルホリニル基; テトラヒドロフリル 基:低級アルキル基及びオキソ基で置換されたジヒドロ ピリジル基; ピペラジニル基; 低級アルコキシカルボニ ル基置換ピペラジニル基;シクロ低級アルキル基;フェ ニル基;低級アルキレンジオキシフェニル基;低級アル キル基で1~2個置換されたフェニル基;低級アルコキ シカルボニル基; 水酸基; 水酸基置換低級アルコキシ 基;カルボキシル基;低級アルコキシ基;保護されてい てもよいアミノ基;ピリジルカルボニルオキシ基;シア ノ基;カルバモイル基;ジ低級アルキルカルバモイル 基:低級アルキル基置換ピリジル低級アルキルカルバモ イル基;モルホリニルカルボニル基;アミノ基;ジ低級 アルキルアミノ基; またはカルボキシルアミノ基等が挙 げられる。これら置換基は、低級アルコキシ基上に同一 または異なって1~3個置換していてもよい。

【0044】本発明の目的化合物〔I〕におけるR¹が置換シクロ低級アルキルオキシ基である場合、シクロ低級アルキルオキシ基上の置換基としては、低級アルコキシカルボニル基、水酸基、カルボキシル基、低級アルキル基、低級アルコキシ基、ヒドロキシ低級アルキル基、保護されていてもよいアミノ基等が挙げられる。これら置換基はシクロ低級アルキル基上に、同一または異なって1~3個置換していてもよい。

【0045】本発明の目的化合物〔I〕におけるR¹が 置換低級アルケニルオキシ基である場合、低級アルケニ ルオキシ基上の置換基としては、例えば、ピペリジニル 基;ピリジル基;イミダゾリル基;低級アルキル基置換 ピペリジニル基;フリル基;モルホリニル基;テトラヒ ドロフリル基;低級アルキル基及びオキソ基で置換され たジヒドロピリジル基;ピペラジニル基;低級アルコキ シカルボニル基置換ピペラジニル基;シクロ低級アルキ ル基;フェニル基;低級アルキレンジオキシフェニル 基;低級アルコキシカルボニル基;水酸基;水酸基置換 低級アルコキシ基;カルボキシル基;低級アルコキシ 基;保護されていてもよいアミノ基;カルバモイル基; ジ低級アルキルアミノ基;ピリジルカルボニルオキシ 基;ピリジン環部分が低級アルキル基で置換されていてもよいピリジルカルボニルアミノ基;低級アルキル基部分がピリジル基、低級アルケニルオキシ基もしくはハロゲン原子で置換されていてもよい低級アルキルカルボニルアミノ基;低級アルコキシカルボニルアミノ基;フェニル基部分が保護されていてもよいアミノ基で置換されていてもよいフェニルカルボニルアミノ基等が挙げられる。これら置換基は低級アルケニルオキシ基上に、同一または異なって1~2個置換していてもよい。

【0046】本発明の目的化合物〔I〕におけるR1が 置換低級アルキニルオキシ基である場合、低級アルキニ ルオキシ基上の置換基としては、例えば、ピペリジニル 基;ピリジル基;イミダゾリル基;低級アルキル基置換 ピペリジニル基:フリル基:モルホリニル基:テトラヒ ドロフリル基: 低級アルキル基及びオキソ基で置換され たジヒドロピリジル基: ピペラジニル基: 低級アルコキ シカルボニル基置換ピペラジニル基;シクロ低級アルキ ル基;フェニル基;低級アルキレンジオキシフェニル 基;低級アルコキシカルボニル基;水酸基;水酸基置換 低級アルコキシ基; カルボキシル基; 低級アルコキシ 基:保護されていてもよいアミノ基:カルバモイル基; ジ低級アルキルアミノ基; ピリジルカルボニルオキシ 基:ピリジン環部分が低級アルキル基で置換されていて もよいピリジルカルボニルアミノ基:低級アルキル基部 分がピリジル基、低級アルケニルオキシ基もしくはハロ ゲン原子で置換されていてもよい低級アルキルカルボニ ルアミノ基;低級アルコキシカルボニルアミノ基;フェ ニル基部分が保護されていてもよいアミノ基で置換され ていてもよいフェニルカルボニルアミノ基等が挙げられ る。これら置換基は低級アルキニルオキシ基上に同一ま たは異なって1~2個置換していてもよい。

【0047】本発明の目的化合物〔I〕におけるR¹が 置換アリールオキシ基である場合、アリールオキシ基上 の置換基としては、例えば、ハロゲン原子、低級アルキ ルアミノ基、ジ低級アルキルアミノ基、モルホリノ基、 低級アルキル基置換ピリミジニル基、低級アルキル基置 換ピラゾリル基、ヒドロキシ低級アルキル基、保護され ていてもよいアミノ基、低級アルカノイル基置換アミノ 基、低級アルコキシ基、低級アルキル基、保護されてい てもよい水酸基、カルボキシル基置換低級アルキル基、 低級アルコキシカルボニル基置換低級アルキル基、低級 アルコキシカルボニル基置換低級アルコキシ基、カルバ モイル基、カルボキシル基、低級アルキルチオ基、低級 アルコキシカルボニル基、ニトロ基、トリハロゲノ低級 アルキル基、モルホリノカルボニル基、カルボキシル基 置換低級アルコキシ基、ジ(低級アルキルスルホニル) アミノ基、モルホリノ低級アルキルカルバモイル基置換 低級アルコキシ基、スルファモイル基、保護されていて もよいアミノ基で置換された低級アルキル基、低級アル キル基及びアミノ基の保護基で置換されたアミノ基、低 級アルキレンジオキシ基、保護されていてもよいアミノ基で置換されたカルバモイル基、低級アルキルスルフィニル基、低級アルキルスルホニル基等が挙げられる。これら置換基はアリールオキシ基上に同一または異なって1~4個置換していてもよい。

【0048】本発明の目的化合物〔I〕におけるR¹が置換複素環式基置換オキシ基である場合、複素環式基置換オキシ基上の置換基としては、水酸基、ハロゲン原子、低級アルキル基、フェニル基置換低級アルキル基、低級アルコキシ基置換低級アルキル基、ピリミジニル基、オキソ基、低級アルコキシ基、保護されていてもよいアミノ基、び低級アルキルアミノ基、フェニル低級アルコキシカルボニル基、低級アルコキシカルボニル基、低級アルコキシカルボニル基、低級アルコキシカルボニル基、大半、基等が挙げられる。これら置換基は複素環式基置換オキシ基上に同一または異なって1~4個置換していてもよい。

【0049】本発明の目的化合物[I]におけるR1が 置換低級アルキルチオ基である場合、低級アルキルチオ 基上の置換基としては、例えば、ピペリジニル基:低級 アルキル基で置換されていてもよいピリジル基;イミダ ゾリル基; ピリミジニル基; 低級アルキル基置換ピペリ ジニル基; フリル基; モルホリニル基; テトラヒドロフ リル基: 低級アルキル基及びオキソ基で置換されたジヒ ドロピリジル基;ピペラジニル基;低級アルコキシカル ボニル基置換ピペラジニル基;シクロ低級アルキル基; フェニル基; 低級アルキレンジオキシフェニル基; 低級 アルキル基で1~2個置換されたフェニル基;低級アル コキシカルボニル基; 水酸基; 水酸基置換低級アルコキ シ基;カルボキシル基;低級アルコキシ基;保護されて いてもよいアミノ基; ピリジルカルボニルオキシ基:シ アノ基;カルバモイル基; ジ低級アルキルカルバモイル 基;低級アルキル基置換ピリジル低級アルキルカルバモ イル基;モルホリニルカルボニル基;アミノ基;ジ低級 アルキルアミノ基; またはカルボキシルアミノ基等が挙 げられる。これら置換基は低級アルキルチオ基上に同一 または異なって1~3個置換していてもよい。

【0050】本発明の目的化合物〔1〕におけるR1が置換アリールチオ基である場合、アリールチオ基上の置換基としては、例えば、ハロゲン原子、低級アルキルアミノ基、ジ低級アルキルアミノ基、モルホリノ基、低級アルキル基置換ピリミジニル基、低級アルキル基置換ピラゾリル基、ヒドロキシ低級アルキル基、保護されていてもよいアミノ基、低級アルカノイル基置換アミノ基、低級アルコキシ基、低級アルキル基、保護されていてもよい水酸基、カルボキシル基置換低級アルキル基、低級アルコキシカルボニル基置換低級アルコキシ基、カルバモイル基、カルボキシル基、低級アルキルチオ基、低級アル

コキシカルボニル基、ニトロ基、トリハロゲノ低級アルキル基、モルホリノカルボニル基、カルボキシル基置換低級アルコキシ基、ジ(低級アルキルスルホニル)アミノ基、モルホリノ低級アルキルカルバモイル基置換低級アルコキシ基、スルファモイル基、保護されていてもよいアミノ基で置換された低級アルキル基、低級アルキル基及びアミノ基の保護基で置換されたアミノ基、低級アルキレンジオキシ基、保護されていてもよいアミノ基で置換されたカルバモイル基、低級アルキルスルフィニル基、低級アルキルスルホニル基等が挙げられる。これら置換基はアリールチオ基上に同一または異なって1~4個置換していてもよい。

【0051】本発明の目的化合物〔Ⅰ〕におけるR¹が 置換低級アルキル基である場合、低級アルキル基上の置 換基としては、例えば、ピペリジニル基; ピリジル基; イミダゾリル基;低級アルキル基置換ピペリジニル基: フリル基;モルホリニル基;テトラヒドロフリル基;低 級アルキル基及びオキソ基で置換されたジヒドロピリジ ル基;ピペラジニル基;低級アルコキシカルボニル基置 換ピペラジニル基;シクロ低級アルキル基;フェニル 基;低級アルキレンジオキシフェニル基;低級アルコキ シカルボニル基;水酸基;水酸基置換低級アルコキシ 基;カルボキシル基;低級アルコキシ基;保護されてい てもよいアミノ基;カルバモイル基;ジ低級アルキルア ミノ基: ピリジルカルボニルオキシ基: ピリジン環部分 が低級アルキル基で置換されていてもよいピリジルカル ボニルアミノ基;低級アルキル基部分がピリジル基、低 級アルケニルオキシ基もしくはハロゲン原子で置換され ていてもよい低級アルキルカルボニルアミノ基;低級ア ルコキシカルボニルアミノ基;フェニル基部分が保護さ れていてもよいアミノ基で置換されていてもよいフェニ ルカルボニルアミノ基等が挙げられる。これら置換基は 低級アルキル基上に、同一または異なって1~3個置換 していてもよい。

【0052】本発明の目的化合物〔I〕におけるR1が 置換アミノ基である場合、アミノ基上の置換基として は、アミノ基の保護基;ピリジル基:低級アルカノイル 基;低級アルキル基;ヒドロキシ低級アルキル基;フェ ニル基; 低級アルカノイルオキシ基置換低級アルキル 基;トリハロゲノ低級アルカノイル基;低級アルコキシ 基で1~3個置換されていてもよいフェニル基;アミノ 基部分が低級アルコキシカルボニル基で置換されていて もよいアミノフェニル基;ジフルオロフェニル基;フェ ニル基部分がハロゲン原子及び低級アルコキシ基で置換 されたフェニル基置換低級アルキル基;ジ低級アルキル アミノ基置換低級アルキル基; ピリジル基部分が低級ア ルキル基で置換されていてもよいピリジル基置換低級ア ルキル基;テトラヒドロフラニル基置換低級アルキル 基:低級アルコキシ基置換低級アルキル基;モルホリニ ル基置換低級アルキル基; ピリミジニルアミノ基置換低 級アルキル基: ジ低級アルキルカルバモイル基置換低級 アルキル基:シクロ低級アルキル基:ジ低級アルキルア ミノ基置換低級アルキル基;低級アルコキシフェニル 基;低級アルコキシカルボニルアミノ基;ピリジルカル ボニルアミノ基: ピリジルカルボニル基: モルホリニル 基;または低級アルキルピペラジニル基等が挙げられ る。これら置換基はアミノ基上に、同一または異なっ て、1~2個置換していてもよい。

【0053】本発明の目的化合物〔I〕におけるR1が 置換複素環式基である場合、複素環式基上の置換基とし ては、水酸基、ハロゲン原子、低級アルキル基、フェニ ル基置換低級アルキル基、低級アルコキシ基置換低級ア ルキル基、ヒドロキシ低級アルキル基、テトラヒドロピ リミジニル基、ピリミジニル基、オキソ基、低級アルコ キシ基、保護されていてもよいアミノ基、低級アルキル アミノ基、シ低級アルキルアミノ基、フェニル低級アル コキシカルボニル基、低級アルコキシカルボニル基、カ ルボキシル基、カルバモイル基またはオキソ基等が挙げ られる。これら置換基は複素環式基上に、同一または異 なって1~4個置換していてもよい。

【0054】本発明の目的化合物〔I〕におけるR1が 置換アリール基である場合、アリール基上の置換基とし ては、例えば、ハロゲン原子、低級アルキルアミノ基、 ジ低級アルキルアミノ基、モルホリノ基、低級アルキル 基置換ピリミジニル基、低級アルキル基置換ピラゾリル 基、ヒドロキシ低級アルキル基、保護されていてもよい アミノ基、低級アルカノイル基置換アミノ基、低級アル コキシ基、低級アルキル基、保護されていてもよい水酸 基、カルボキシル基置換低級アルキル基、低級アルコキ シカルボニル基置換低級アルキル基、低級アルコキシカ ルボニル基置換低級アルコキシ基、カルバモイル基、カ ルボキシル基、低級アルキルチオ基、低級アルコキシカ ルボニル基、ニトロ基、トリハロゲノ低級アルキル基。 モルホリノカルボニル基、カルボキシル基置換低級アル コキシ基、ジ(低級アルキルスルホニル)アミノ基、モ

ルホリノ低級アルキルカルバモイル基置換低級アルコキ シ基、スルファモイル基、保護されていてもよいアミノ 基で置換された低級アルキル基、低級アルキル基及びア ミノ基の保護基で置換されたアミノ基、低級アルキレン ジオキシ基、保護されていてもよいアミノ基で置換され たカルバモイル基、低級アルキルスルフィニル基、低級 アルキルスルホニル基等が挙げられる。これら置換基は アリール基上に同一または異なって1~4個置換してい てもよい。

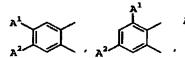
【0055】上記本発明の目的化合物〔Ⅰ〕が保護され たアミノ基を有する場合は、当該アミノ基の保護基とし ては、例えば、置換もしくは非置換低級アルコキシカル ボニル基、低級アルカノイル基等が挙げられ、具体的に は、ベンジルオキシカルボニル基、4-メトキシベンジ ルオキシカルボニル基、9-フルオレニルメトキシカル ボニル基、tert-ブトキシカルボニル基、2,2, 2-トリクロロエチルオキシカルボニル基、ホルミル 基、アセチル基、プロピオニル基、ブチリル基等が挙げ られる。このうち好ましいものとしては、置換もしくは 非置換低級アルコキシカルボニル基が挙げられ、具体的 には、ベンジルオキシカルボニル基及びtert-ブト キシカルボニル基が挙げられる。

【0056】更に本発明の目的化合物〔Ⅰ〕が保護され た水酸基を有する場合は、当該水酸基の保護基として は、置換もしくは非置換アリール低級アルキル基、アシ ル基等の慣用の保護基を挙げることができる。このうち 好ましいものとしては、例えば、ベンジル基、フェネチ ル基等の如き非置換アリール低級アルキル基、ホルミル 基、アセチル基、プロピオニル基、マロニル基、アクリ ロイル基、ベンゾイル基等のアシル基が挙げられる。

【0057】本発明の目的化合物のうち、より好ましい 化合物としては、環Aが式:

[0058]

【化15】



【0059】で示されるベンゼン環であり、環Bが式: [0060]

【化16】

$$B^1$$
 B^2

【0061】で示されるベンゼン環であり、A1及びA2 が、同一または異なって、(1)保護された水酸基、 (2) ヒドロキシ低級アルキル基置換ピリジル基、ピリ

ジル基、N-オキソピリジル基、ピラジニル基、ピリミ ジニル基、低級アルキル基置換ピリミジニル基、モルホ リニル基、ピペリジニル基、低級アルキル基置換ピロリ ジニル基、ピロリジニル基、ピペラジニル基、キノリ ル、イソキノリル、アミノ基置換フェニル基、低級アル キルアミノ基置換フェニル基、ジ低級アルキルアミノ基 置換フェニル基、低級アルコキシ基置換フェニル基、ヒ ドロキシ低級アルキル基置換フェニル基、カルボキシル 基置換フェニル基、低級アルコキシ基及びジ低級アルキ ルアミノ基から選ばれる基で置換されていてもよい低級 アルコキシ基、(3)ピリジル基置換低級アルケニル基

または(4)ピリジル基置換低級アルキル基であり、B 1、B2及びB3が、同一または異なって、保護されてい てもよい水酸基、低級アルコキシ基、低級アルキル基ま たはハロゲン原子であり、R¹が、(1)水酸基;カル ボキシル基;低級アルコキシ基;シクロ低級アルキル 基;低級アルキル基で置換されていてもよいピリジル 基;ピリミジニル基;ピペラジニル基;ピペリジニル 基;モルホリニル基;シアノ基;低級アルコキシ基で1 ~2個置換されていてもよいフェニル基:低級アルコキ シカルボニル基;カルバモイル基;ジ低級アルキルカル バモイル基;低級アルキルピリジル基置換低級アルキル カルバモイル基; モルホリニルカルボニル基; アミノ 基;及びジ低級アルキルアミノ基から選ばれる基で置換 されていてもよい低級アルコキシ基、(2)シクロ低級 アルキルオキシ基、(3)低級アルケニルオキシ基、 (4)低級アルキニルオキシ基、(5)ジ低級アルコキ シフェノキシ基、(6)低級アルコキシカルボニル基で 置換されていてもよいピペリジニルオキシ基、(7)フ ェニル基置換低級アルキルチオ基、(8)フェニルチオ 基、(9)ピリジン環部分が低級アルキル基で置換され ていてもよいピリジルカルボニルアミノ基:低級アルキ ル基部分がピリジル基、低級アルケニルオキシ基もしく はハロゲン原子で置換されていてもよい低級アルキルカ ルボニルアミノ基;低級アルコキシカルボニルアミノ 基;フェニル基部分が保護されていてもよいアミノ基で 置換されていてもよいフェニルカルボニルアミノ基;及 びアミノ基から選ばれる基で置換されていてもよい低級 アルキル基、(10)低級アルコキシ基で1~3個置換 されていてもよいフェニル基; アミノ基部分が低級アル コキシカルボニル基で置換されていてもよいアミノフェ ニル基:ジフルオロフェニル基;低級アルキル基;ヒド ロキシ低級アルキル基;フェニル基部分がハロゲン原子 及び低級アルコキシ基で置換されたフェニル基置換低級 アルキル基;ピリジル基部分が低級アルキル基で置換さ れていてもよいピリジル基置換低級アルキル基;テトラ ヒドロフラニル基置換低級アルキル基;低級アルコキシ 基置換低級アルキル基;モルホリニル基置換低級アルキ ル基;ピリミジニルアミノ基置換低級アルキル基;ジ低 級アルキルカルバモイル基置換低級アルキル基:低級ア ルコキシカルボニルアミノ基;低級アルコキシカルボニ ル基: ピリジルカルボニル基: モルホリニル基: 及び低 級アルキルピペラジニル基から選ばれる基で1~2個置 換されていてもよいアミノ基、(11)ピリジル基、 (12) N-オキソピリジル基、(13) ピリミジニル 基、(14)水酸基で置換されていてもよい低級アルキ ル基; テトラヒドロピリミジニル基; 及びピリミジニル 基から選ばれる基で置換されていてもよいピペラジニル 基、(15)低級アルコキシ基置換低級アルキル基もし くはヒドロキシ低級アルキル基で置換されていてもよい

モルホリニル基、(16)イミダゾリル基、(17)テ

トラゾリル基、(18)水酸基、ヒドロキシ低級アルキ ル基及び低級アルコキシカルボニル基から選ばれる基で 置換されていてもよいピペリジニル基、(19)水酸基 置換オキサゼピニル基、(20)水酸基もしくは低級ア ルキルアミノ基で置換されていてもよいピロリジニル 基、(21)ピリドニル基、(22)トリ低級アルコキ シ基置換フェニル基、(23)シアノ基または(24) ハロゲン原子であり、 R^2 が式: $-COOR^3$ または式: -CON(R4)(R5)で示される基であり、R3が水 素原子または低級アルキル基、-N(R4)(R5)で示 される基が、水酸基、ヒドロキシ低級アルキル基置換ピ ペラジニル基、低級アルキル置換ピリジル基、モルホリ ノ基、ピロリジニル基、ピペリジニル基、イミダゾリル 基、シクロ低級アルキル基で置換された低級アルキルア ミノ基または低級アルキル基部分が水酸基で1~2個置 換されていてもよいジ低級アルキルアミノ基である化合 物が挙げられる。

【0062】本発明の目的化合物〔I〕のうち、さらに 好ましい化合物としては、環Aが式:

[0063]

【化17】

【0064】で示されるベンゼン環であり、環Bが式: 【0065】

【化18】

$$B^1$$
 B^2 B^3

【0066】で示されるベンゼン環であり、A¹が (1) ヒドロキシ低級アルキル基置換ピリジル基、ピリ ジル基、N-オキソピリジル基、ピラジニル基、ピリミ ジニル基、モルホリニル基、ピペリジニル基、低級アル キル基置換ピロリジニル基、ピロリジニル基、ピペラジ ニル基、低級アルコキシ基、ジ低級アルキルアミノ基及 びフェニル基から選ばれる基で置換されていてもよい低 級アルコキシ基、(2)ピリジル基置換低級アルケニル 基または(3)ピリジル基置換低級アルキル基であり、 B1、B2及びB3が、同一または異なって、低級アルコ キシ基であり、R1が(1)水酸基;カルボキシル基; 低級アルコキシ基;シクロ低級アルキル基;低級アルキ ル基で置換されていてもよいピリジル基;ピリミジニル 基;ピペラジニル基;ピペリジニル基;モルホリニル 基;シアノ基;低級アルコキシ基で1~2個置換されて いてもよいフェニル基;低級アルコキシカルボニル基; カルバモイル基: ジ低級アルキルカルバモイル基: 低級 アルキルピリジル基置換低級アルキルカルバモイル基; モルホリニルカルボニル基;アミノ基;及びジ低級アル キルアミノ基から選ばれる基で置換されていてもよい低 級アルコキシ基、(2)シクロ低級アルキルオキシ基、

(3)低級アルケニルオキシ基、(4)低級アルキニルオキシ基、(5)ジ低級アルコキシフェノキシ基、

(6)低級アルコキシカルボニル基で置換されていても よいピペリジニルオキシ基、(7)フェニル基置換低級 アルキルチオ基、(8)フェニルチオ基、(9)ピリジ ン環部分が低級アルキル基で置換されていてもよいピリ ジルカルボニルアミノ基;低級アルキル基部分がピリジ ル基、低級アルケニルオキシ基もしくはハロゲン原子で 置換されていてもよい低級アルキルカルボニルアミノ 基;低級アルコキシカルボニルアミノ基;フェニル基部 分が保護されていてもよいアミノ基で置換されていても よいフェニルカルボニルアミノ基:及びアミノ基から選 ばれる基で置換されていてもよい低級アルキル基、(1) 0)低級アルコキシ基で1~3個置換されていてもよい フェニル基; アミノ基部分が低級アルコキシカルボニル 基で置換されていてもよいアミノフェニル基:ジフルオ ロフェニル基;低級アルキル基;ヒドロキシ低級アルキ ル基;フェニル基部分がハロゲン原子及び低級アルコキ シ基で置換されたフェニル基置換低級アルキル基: ピリ ジル基部分が低級アルキル基で置換されていてもよいピ リジル基置換低級アルキル基: テトラヒドロフラニル基 置換低級アルキル基; 低級アルコキシ基置換低級アルキ ル基;モルホリニル基置換低級アルキル基;ピリミジニ ルアミノ基置換低級アルキル基; ジ低級アルキルカルバ モイル基置換低級アルキル基;低級アルコキシカルボニ ルアミノ基:低級アルコキシカルボニル基;ピリジルカ ルボニル基:モルホリニル基:及び低級アルキルピペラ ジニル基から選ばれる基で1~2個置換されていてもよ いアミノ基、(11)ピリジル基、(12)N-オキソ ピリジル基、(13)ピリミジニル基、(14)水酸基 で置換されていてもよい低級アルキル基;テトラヒドロ ピリミジニル基:及びピリミジニル基から選ばれる基で 置換されていてもよいピペラジニル基、(15)低級ア ルコキシ基置換低級アルキル基もしくはヒドロキシ低級 アルキル基で置換されていてもよいモルホリニル基、 (16) イミダゾリル基、(17) テトラゾリル基、

(18)水酸基、ヒドロキシ低級アルキル基及び低級アルコキシカルボニル基から選ばれる基で置換されていてもよいピペリジニル基、(19)水酸基置換オキサゼピニル基、(20)水酸基もしくは低級アルキルアミノ基で置換されていてもよいピロリジニル基、(21)ピリドニル基、(22)トリ低級アルコキシ基置換フェニル基、(23)シアノ基または(24)ハロゲン原子であ

【0067】本発明の目的化合物〔Ⅰ〕のうち、薬効上

り、R2が低級アルコキシカルボニル基である化合物が

好ましい化合物としては、環Aが式:

[0068]

【化19】

【0069】で示されるベンゼン環であり、環Bが式: 【0070】

【化20】

$$\mathbb{R}^1$$
 \mathbb{R}^2 \mathbb{R}^3

【0071】で示されるベンゼン環であり、A¹がピリ ジル基、Nーオキソピリジル基、ピリミジニル基及びフ ェニル基から選ばれる基で置換された低級アルコキシ基 であり、B1、B2及びB3が、同一または異なって低級 アルコキシ基であり、R1が(1)低級アルキルピリジ ル基又はカルバモイル基で置換された低級アルコキシ 基、(2)低級アルキルピリジルカルボニルアミノ基置 換低級アルキル基、(3)フェニル基部分がハロゲン原 子及び低級アルコキシ基で置換されたフェニル基置換低 級アルキル基:及びジ低級アルキルアミノ基置換低級ア ルキル基から選ばれる基で置換されたアミノ基、(4) ピリジル基、(5)N-オキソピリジル基、(6)ピリ ミジニル基、(7)テトラヒドロピリミジニル基置換ピ ペラジニル基、(8)フェニル基置換低級アルキルチオ 基または(9)トリ低級アルコキシフェニル基であり、 R²が低級アルコキシカルボニル基である化合物が挙げ られ、これらのうち、より薬効上好ましい化合物として は、A¹がピリジル基またはフェニル基で置換された低 級アルコキシ基であり、R1が、(1)フェニル基部分 がハロゲン原子及び低級アルコキシ基で置換されたフェ ニル基置換低級アルキル基:及びジ低級アルキルアミノ 基置換低級アルキル基から選ばれる基で置換されたアミ ノ基、(2)ピリジル基、(3)N-オキソピリジル基 または(4)ピリミジニル基、R²が低級アルコキシカ ルボニル基である化合物が挙げられる。

【0072】本発明の目的化合物〔I〕は、環A及び環B上の置換基及び/またはR¹が不斉原子を有する場合、当該不斉原子に基づく光学異性体として存在しうるが、本発明はこれらの光学異性体及びその混合物のいずれをも含むものである。

【0073】本発明の目的化合物〔I〕またはその薬理的に許容しうる塩は、cGMP特異的PDE阻害作用、特に優れた選択的ホスホジエステラーゼV(PDE V)阻害作用を有し、PDE V阻害作用に基づき、優れた血管拡張作用、肺動脈圧低下作用、陰茎内圧上昇作

挙げられる。

用、摘出血管弛緩作用、海綿体弛緩作用、血管平滑筋増 殖抑制作用、心肥大抑制作用、血小板凝集抑制作用等を 示す。

(

【0074】従って、本発明の目的化合物〔1〕またはその薬理的に許容し得る塩は、慢性心不全、狭心症、陰茎勃起不全、高血圧症、肺高血圧症、動脈硬化、PTC A後再狭窄等の予防・治療剤として有用な医薬化合物であり、かつ、副作用をほとんど示さず、低毒性であるという特長を有するため、医薬として安全性が高いという特長をも有する。

【0075】本発明の目的化合物〔I〕は、遊離の形でも、また、薬理的に許容し得る塩の形でも医薬用途に使用することができる。化合物〔I〕の薬理的に許容しうる塩としては、例えば塩酸塩、硫酸塩又は臭化水素酸塩の如き無機酸塩、酢酸塩、フマル酸塩、シュウ酸塩、クエン酸塩、メタンスルホン酸塩、トシル酸塩またはマレイン酸塩の如き有機酸塩等が挙げられる。また、カルボキシル基等の置換基を有する場合には塩基との塩(例えばナトリウム塩、カリウム塩等のアルカリ金属塩又はカルシウム塩の如きアルカリ土類金属塩)が挙げられる。【0076】本発明の目的化合物〔I〕またはその塩は、その分子内塩や付加物、それらの溶媒和物あるいは

【0077】本発明の目的化合物〔I〕またはその薬理的に許容しうる塩は、経口的にも非経口的にも投与することができ、また、錠剤、顆粒剤、カプセル剤、散剤、注射剤、吸入剤等の慣用の医薬製剤として用いることができる。

水和物等をいずれも含むものである。

【0078】本発明の目的化合物 [I]またはその薬理的に許容し得る塩の投与量は、投与方法、患者の年令、体重、状態によっても異なるが、注射剤とすれば、通常、1日当り約 $0.001\sim1.0$ mg/kg、とりわけ約 $0.0005\sim0.5$ mg/kg程度、経口剤とすれば、通常、1日当り約 $0.001\sim30$ mg/kg、とりわけ約 $0.05\sim10$ mg/kg程度とするのが好ましい。

【 0 0 7 9 】 本発明の目的化合物 〔 I 〕は、下記 〔 A 法 〕、〔 B 法 〕、または 〔 C 法 〕によって製造することができる。

【0080】 [A法] 本発明の目的化合物 [I] のうち 一般式 [I-a]

[0081]

【化21】

【0082】(但し、R11はハロゲン原子を表わし、他

の記号は前記と同一意味を有する。) で示されるイソキ ノリン誘導体は、一般式〔II〕

[0083]

【化22】

【0084】(但し、記号は前記と同一意味を有する。)で示されるイソキノリノン誘導体またはその塩をハロゲン化することにより製造することができる。

【0085】 [B法] 本発明の目的化合物 [I] のうち 一般式 [I-b]

[0086]

【化23】

【〇〇87】(但し、R¹²は置換もしくは非置換低級アルコキシ基、置換もしくは非置換シクロ低級アルキルオキシ基、置換もしくは非置換低級アルケニルオキシ基、置換もしくは非置換低級アルキニルオキシ基、置換もしくは非置換低級アリールオキシ基または置換もしくは非置換複素環式基置換オキシ基を表わし、他の記号は前記と同一意味を有する。)で示されるイソキノリン誘導体は、化合物〔II〕またはその塩と一般式〔III〕

[0088]

【化24】

$$R^{12}-W$$
 [III]

【0089】(但し、Wは脱離基を表わし、他の記号は前記と同一意味を有する。)で示される化合物またはその塩を反応させることにより製造することができる。

【 0 0 9 0 】 〔 C 法 〕 本発明の目的化合物 〔 I 〕 のうち 一般式 〔 I ー c 〕

[0091]

【化25】

【0092】(但し、R¹³は置換もしくは非置換低級アルコキシ基、置換もしくは非置換シクロ低級アルキルオキシ基、置換もしくは非置換低級アルケニルオキシ基、

置換もしくは非置換低級アルキニルオキシ基、置換もしくは非置換アリールオキシ基、置換もしくは非置換複素環式基置換オキシ基、置換もしくは非置換低級アルキルチオ基、置換もしくは非置換アリールチオ基、置換もしくは非置換でリール基、置換もしくは非置換でまりを表しては非置換でリール基とはシアノ基を表わし、他の記号は前記と同一意味を有する。)で示されるイソキノリン誘導体は、化合物〔Iーa〕またはその塩と一般式〔IV〕【0093】

【化26】

$R^{13}-Y$ [IV]

【0094】(但し、Yは脱離基を表わし、他の記号は前記と同一意味を有する。)で示される化合物を反応させることにより製造することができる。

【0095】これら[Ak]、[Bk]及び[Ck]で得られる化合物[I-a]、[I-b]及び[I-c]は、所望により、その薬理的に許容しうる塩とすることができる。

【0096】上記〔A法〕、〔B法〕及び〔C法〕は以下のようにして実施することができる。

【0097】〔A法〕イソキノリノン誘導体〔II〕のハロゲン化反応は、ハロゲン化剤の存在下、溶媒中または無溶媒で実施することができる。ハロゲン化剤としては、オキシ塩化リン、オキシ臭化リン、五塩化リン等を用いることができる。溶媒としては、クロロホルム、塩化メチレン、ジクロロエタン、ベンゼン、トルエン、キシレン等の溶媒を用いることができる。本反応は、30~150℃、とりわけ、50~100℃で好適に進行する。

【0098】 [B法] イソキノリノン誘導体 [II] と 化合物 [III] との反応は、塩基の存在下、溶媒中で 実施することができる。

【0099】化合物〔III〕における脱離基(W)としては、水酸基、トリフルオロメタンスルホニルオキシ基、pートシルオキシ基、メタンスルホニルオキシ基あるいは塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等のハロゲン原子等が挙げられる。

【0100】即ち、化合物〔III〕と化合物〔III〕 との反応は、脱離基が水酸基である場合、例えば、光延等の方法(シンセシス(Synthesis),第1~ 28頁,1981年)に準じて行うことができる。具体的には、ジエチルアゾジカルボキシレート及びトリフェニルホスフィンの存在下、化合物〔II〕と化合物〔I II〕をテトラヒドロフラン、ジオキサン、酢酸エチル、ジメチルホルムアミド、クロロホルム、塩化メチレン、ベンゼン、トルエン、ジメトキシエタン等の溶媒中反応させることにより製することができる。本反応は、例えば、0~60℃、とりわけ、5~40℃で好適に進行する。 【0101】また、化合物〔III〕と化合物〔III〕との反応は、化合物〔III〕の脱離基が、トリフルオロメタンスルホニルオキシ基、ロートシルオキシ基、メタンスルホニルオキシ基、或いは塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等のハロゲン原子である場合には、塩基の存在下に実施することができる。塩基としては、例えば、炭酸銀、炭酸カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸オトリウム、水素化ナトリウム、トリエチルアミン、1,8ージアザビシクロ[5.4.0]ー7ーウンデセン等を挙げることができる。また、塩基の使用量としては、化合物〔II〕に対して、通常1~5当量、好ましくは、1~2当量用いることができる。なお、炭酸銀を用いた場合、反応を遮光下で行うのが好ましい。

【0102】 [C法] 化合物 [I-a] と化合物 [I V] との反応は、塩基の存在下もしくは非存在下、溶媒 中または無溶媒で実施することができる。

【0103】また、反応を容易に進行させるために触媒を添加することもできる。

【0104】化合物〔IV〕における脱離基(Y)としては、水素原子、リチウム、ナトリウム、カリウム、塩化マグネシウム、臭化マグネシウム、ヨウ化マグネシウム、トリメチルスズ、トリブチルスズ、ほう酸(またはその無水物もしくはエステル)、ジメチルホウ素、ジエチルホウ素等が挙げられる。

【0105】溶媒としては、テトラヒドロフラン、ジオキサン、酢酸エチル、ジメチルホルムアミド、クロロホルム、塩化メチレン、ベンゼン、トルエン、ジメトキシエタン等を用いることができる。塩基としては、水素化ナトリウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸セシウム、炭酸水素ナトリウム、トリエチルアミン、1、8ージアザビシクロ[5.4.0]ー7ーウンデセン等を用いることができる。本反応は、例えば、0~200℃、とりわけ、5~130℃で好適に進行する。

【0106】具体的には、例えば、R13が、置換もしくは非置換低級アルコキシ基、置換もしくは非置換低級アルケニルオキシ基、置換もしくは非置換低級アルケニルオキシ基、置換もしくは非置換アリールオキシ基、置換もしくは非置換複素環式基置換オキシ基、置換もしくは非置換低級アルキルチオ基、置換もしくは非置換でリールチオ基である場合、Yとしては水素原子、リチウム、ナトリウム、カリウム等、溶媒としてはジメチルホルムアミド、テトラヒドロフラン、ジオキサン、塩化メチレン、ベンゼン、トルエン、ジメトキシエタン等、塩基としては水素化ナトリウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸セシウム、炭酸水素ナトリウム、片リエチルアミン、1、8ージアザビシクロ[5.4.0]-7ーウンデセン等、反応温度は5℃~130℃が好ましい

【0107】R¹³が、置換もしくは非置換低級アルキル基、置換もしくは非置換含窒素複素環式基(イソキノリ

ン環部分と炭素-炭素結合の場合)、置換もしくは非置 換アリール基である場合、Yとしてはトリメチルスズ、 トリブチルスズ、ほう酸(またはその無水物もしくはエ ステル)、ジメチルホウ素、ジエチルホウ素、リチウ ム、マグネシウム化合物(塩化マグネシウム、臭化マグ ネシウム、ヨウ化マグネシウム等)等が好ましい。溶媒 としてはジメチルホルムアミド、テトラヒドロフラン、 ジオキサン、塩化メチレン、ベンゼン、トルエン、ジメ トキシエタン等が好ましく、特にジメチルホルムアミド が好ましい。塩基としては炭酸ナトリウム、炭酸カリウ ム等のアルカリ金属炭酸塩、ナトリウムメトキシド、ナ トリウムエトキシド等のアルカリ金属アルコキシド、水 酸化ナトリウム、水酸化カリウム等のアルカリ金属水酸 化物等の無機塩基、トリエチルアミン、ジイソプロピル エチルアミン、1,8-ジアザビシクロ[5.4.0] -7-ウンデセン等の有機塩基が好ましく、特に炭酸ナ トリウム、炭酸カリウム等のアルカリ金属炭酸塩が好ま しい。反応温度は5℃~130℃が好ましい。また、当 該反応は、適当な触媒存在下で実施することが好まし い。触媒としては、パラジウムまたはニッケル触媒が挙 げられ、このうちパラジウム触媒、具体的には、塩化ビ ス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(II)、塩 化パラジウム(II)、酢酸パラジウム(II)、酸化 パラジウム(II)、テトラキス(トリフェニルホスフ ィン)パラジウム(0)、トリス(ジベンジリデンアセ トン)ジパラジウム(0)等が好ましい。なお、触媒は 反応系で作成することも可能で、酢酸パラジウムとトリ オルソトルイルホスフィンを用いることもできる。反応 温度は20℃~120℃が好ましい。

【0108】R13が、置換もしくは非置換含窒素複素環 式基(イソキノリン環部分と炭素-窒素結合の場合)、 置換もしくは非置換アミノ基である場合、Yとしては水 素原子等、溶媒としてはジメチルホルムアミド、イソプ ロピルアルコール、ジメチルスルホキシド、トルエン、 テトラヒドロフラン、ジオキサン、塩化メチレン等、塩 基としては炭酸セシウム、炭酸カリウム、トリエチルア ミン、ピリジン、1,8-ジアザビシクロ「5.4. 0]-7-ウンデセン等、反応温度は、反応溶媒の還流 温度が好ましい。なお、当該反応は、触媒を添加しても よく、触媒としては、ヨウ化銅(I)、塩化銅(I)、 臭化銅(I)、酸化銅(II)等の銅触媒、酢酸パラジ ウム(II)等のパラジウム触媒、酢酸ニッケル等のニ ッケル触媒を用いることができ、ヨウ化銅(I)、酸化 銅(II)、酢酸パラジウム(II)が好ましい。さら に、必要に応じ、配位子を添加してもよく、配位子とし ては、ジフェニルホスフィノエタン、ジフェニルホスフ ィノプロパン、ジフェニルホスフィノフェロセン、2, 2'ービス(ジフェニルホスフィノ)-1,1'ービナフ チル等があげられ、ジフェニルホスフィノフェロセンが 好ましい。また、触媒として酢酸パラジウム、配位子と

してジフェニルホスフィノフェロセンの組み合わせが好ましい。 反応温度は20℃~140℃が好ましい。

【0109】R¹³が、シアノ基である場合、Yとしてはナトリウム、カリウム等のアルカリ金属等、溶媒としてはジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド等が好ましい。反応温度は100℃~160℃が好ましい。また、反応はトルエンスルホン酸ナトリウムの存在下行うことが好ましい。

【0110】また上記〔A法〕、〔B法〕及び〔C法〕で用いられる化合物〔III〕及び〔IV〕のR¹²、R ¹³がアミノ基或いはアミノ基を含む置換基である場合は、当該アミノ基に保護基(例えば、tert-ブトキシカルボニル基、ベンジルオキシカルボニル基等の如き置換もしくは非置換低級アルコキシカルボニル基、ホルミル、アセチル基、プロピオニル基等の如き低級アルカノイル基等)を導入してから本反応を実施するのが望ましい。

【0111】上記 [A法]、 [B法]及び [C法]で得られる化合物 [I] の基 R^2 がカルボキシル基である目的化合物 [I]、即ち、一般式 [I-d]

[0112]

【化27】

【 0 1 1 3 】 (但し、記号は前記と同一意味を有する。)で示される化合物は常法でエステル化することにより、一般式〔 I - e 〕

【0114】 【化28】

【0115】(式中、R³¹はエステル残基を表し、他の記号は前記と同一意味を有する。)で示される目的化合物に変換することができる。例えば、化合物 [I-e]は、化合物 [I-d]とアルキル化剤とを、脱酸剤の存在下または非存在下、溶媒中で反応させることにより製することができる。脱酸剤としては、水酸化アルカリ金属、炭酸アルカリ金属等の無機塩基、N-メチルモルホリン、トリエチルアミン、ピリジン、1,5-ジアザビシクロ [4.3.0]-5-ノネン、1,8-ジアザビシクロ [5.4.0]-7-ウンデセン等の有機塩基を好適に用いることができる。アルキル化剤としては、ジ

アゾメタン、ジアゾエタン等のジアゾアルカン、硫酸ジ メチル、硫酸ジエチル等の硫酸ジアルキル、ヨウ化メチ ル、臭化メチル、臭化エチル等のアルキルハライド、ト リメチルシリルジアゾメタン等のトリ低級アルキルシリ ルジアゾアルカン、ベンジルクロリド、ベンジルブロミ ド等のアリール低級アルキルハライド等が挙げられる。 アルキル化剤として硫酸ジアルキル、アルキルハライド またはアリール低級アルキルハライドを使用する場合 は、脱酸剤を化合物 [I - d] に対して、通常 1 ~ 5 当 量、好ましくは1~2当量用いることができる。本反応 は、0~60℃、とりわけ5~40℃で好適に進行す る。また、アルキル化剤としてジアゾアルカンを使用す る場合、化合物 [I - d] に対して、通常1~5当量、 好ましくは、1~2当量用いることができる。本反応 は、0~50℃、とりわけ5~30℃で好適に進行す る。なお、-COOR3がメトキシカルボニル基である 化合物〔І-е〕は、前記の方法において、アルキル化 剤としてトリメチルシリルジアゾメタンを用いれば、緩 和な条件下で製造することができる。溶媒としては、水 の他、メタノール、エタノール、イソプロピルアルコー ル等のアルコール類、ジエチルエーテル、テトラヒドロ フラン、ジオキサン等のエーテル類、アセトン、メチル エチルケトン等のケトン類、酢酸メチル、酢酸エチル等 のエステル類、ベンゼン、トルエン等の芳香族炭化水素 類、塩化メチレン、クロロホルム等のハロゲン化炭化水 素類、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド等 のアミド類、ジメチルスルホキシド等のスルホキシド、 あるいはこれらの混合溶媒を用いることができる。

【0116】また化合物 [I-e]は、化合物 [I-d]と酸性条件下、メタノール、エタノール、プロパノール、ブタノール等の低級アルコールや、ベンジルアルコール、フェネチルアルコール等のアリール低級アルコールと反応させることにより製することもできる。酸としては、硫酸、塩化水素、p-トルエンスルホン酸等を化合物 [I-d]に対して、通常、0.01~20当量、好ましくは、0.1~10当量用いることができる。本反応は、該アルコール中、加熱還流下で好適に進行する。

【0117】ここで、上記化合物〔I-d〕が、3位カルボキシル基以外に、1個以上のカルボキシル基またはモノ置換もしくは非置換アミノ基を有する化合物である場合には、同化合物を上記アルキル化剤と反応させることにより、該カルボキシル基がアルキル化された対応化合物或いは該アミノ基が低級アルキルアミノ基もしくはジ低級アルキルアミノ基に変換された化合物に変換することもできる。

【0118】また、基 R^2 が、式: $-CON(R^4)(R^5)$ で示される基である目的化合物〔I〕、即ち、一般式〔I-f〕

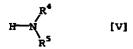
[0119]

【化29】

【0120】(但し、記号は前記と同一意味を有する。)で示される化合物は、化合物〔I-d〕と一般式〔V〕

[0121]

【化30】



【0122】(但し、記号は前記と同一意味を有す る。) で示されるアミン化合物とを縮合剤の存在下反応 させるか、或いは、化合物 [I-d] の誘導体 (酸ハラ イド、酸無水物、活性アミド、活性エステル、混合酸無 水物、エステル等)とアミン化合物 [V]とを、塩基の 存在下または非存在下、溶媒中で反応させることにより 製することもできる。塩基とじては、ピリジン、4-ジ メチルアミノピリジン、N-メチルモルホリン、トリエ チルアミン、N, N-ジメチルアニリン、N, N-ジエ チルアニリン、1,8-ジアザビシクロ[5.4.0] -7-ウンデセン等の有機塩基、炭酸水素ナトリウム、 炭酸水素カリウム、炭酸ナトリウム等の無機塩基等を好 適に用いることができる。縮合剤としては、1,3-ジ シクロヘキシルカルボジイミド、1-(3-ジメチルア ミノプロピル)-3-エチルカルボジイミド塩酸塩、プ ロパンホスホン酸無水物等を好適に用いることができ る。溶媒としては、ジメチルホルムアミド、塩化メチレ ン、テトラヒドロフラン、ジオキサン、酢酸エチル、 3-ジメチルー2ーイミダゾリジノン等を用いるこ とができる。本反応は、−20~60℃、とりわけ5~ 40℃で好適に進行する。

【 0 1 2 3 】 化合物 〔 I - d 〕 の活性エステルとしては、N-ヒドロキシコハク酸イミド、N-ヒドロキシフタル酸イミド、1-ヒドロキシベンゾトリアゾールまたはp-ニトロフェノールとのエステル等を好適に用いることができる。

【0124】化合物〔I-d〕の酸ハライドとしては、 酸塩化物、酸臭化物等を好適に用いることができる。

【0125】また化合物 [I-d] の活性アミドとしては、イミダゾール等とのアミドを好適に用いることができる.

【0126】本発明の目的化合物 [I]は、上記の如くして得られる化合物の環A上の置換基及び/または基R1を目的とする他の置換基へ変換することによっても製造することができる。このような置換基の変換方法は、

目的とする置換基の種類に応じて適宜選択すればよいが、例えば次の(a法) \sim (1法)の如く実施することができる。

(

【0127】(a法):一般式[I]において基R¹が遊離カルボキシル基を含有する置換基(例えば、カルボキシ低級アルキル基、カルボキシル基置換フェニル基等)である目的化合物[I]は、基R¹がエステル化されたカルボキシル基を含有する置換基である対応化合物[I]を常法により脱エステル化(例えば、エステル残基の種類に応じて水酸化ナトリウム等の塩基による加水分解、トリフルオロ酢酸、塩化水素、臭化水素等による酸処理、水素雰囲気下、パラジウム(黒)、パラジウム炭素等を用いた還元等)することにより製することができる。本脱エステル反応のうち、塩基による加水分解反応は、例えば、5~70℃、酸処理は、5~80℃、還元は、10~40℃で実施することができる。

【0128】(b法):一般式[I]において基R!がカルバモイル基、ジ低級アルキルカルバモイル基及び低級アルキル基で置換ピリジル低級アルキルカルバモイル基から選ばれる基で置換された低級アルコキシ基またはモルホリノカルボニル基で置換された低級アルコキシ基である目的化合物[I]は、基R!がカルボキシル基置換低級アルキル基である対応化合物[I]と一般式:

[0129]

【化31】

【0130】(式中、Ra及びRbは一方が水素原子 で、他方がアミノ基の保護基または低級アルキル基置換 ピリジル低級アルキル基であるか、Ra及びRbが、同 一または異なって、低級アルキル基であるか、或いは両 者が互いに末端で結合して隣接する窒素原子と共にモル ホリノ基を形成していることを表す。) で示されるアミ ン化合物とを縮合剤の存在下反応させることにより製す ることができる。縮合剤としては、カルボン酸とアミン からアミド結合形成反応に通常用いられる、1,1-カ ルボニルジイミダゾール、1,3-ジシクロヘキシルカ ルボジイミド、1-エチル-3-(3-ジメチルアミノ プロピル) カルボジイミド塩酸塩、クロロギ酸イソブチ ル又はN-メチルモルホリン等を用いることができる。 本反応は、例えば、○~50℃で実施することができ る。また当該生成物の基RaまたはRbがアミノ基の保 護基である場合には、所望により、当該保護基を慣用の 方法により除去することができる。

【0131】(c法):一般式[I]において基R 」が、ハロゲン原子、ピリジル基もしくは低級アルケニ ル基で置換されていてもよい低級アルキル基;低級アル キル基で置換されていてもよいピリジル基;及び保護さ れていてもよいアミノ基で置換されたフェニル基から選 ばれる基で置換されたカルボニルアミノ基低級アルキル 基である目的化合物 [I]は、基R¹がアミノ基置換低 級アルキル基である対応化合物 [I]と一般式:

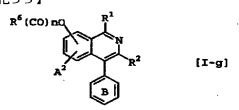
【0132】 【化32】

Rc-COOH

【0133】 (式中、Rcは、ハロゲン原子、ピリジル 基もしくは低級アルケニル基で置換されていてもよい低 級アルキル基: 低級アルキル基で置換されていてもよい ピリジル基;または保護されていてもよいアミノ基で置 換されたフェニル基を表す。) で示される化合物または その誘導体(酸ハライド、酸無水物、活性アミド、活性 エステル、混合酸無水物、エステル等) とを縮合剤の存 在下または非存在下反応させることにより製することが できる。縮合剤としては、カルボン酸とアミンからアミ ド結合形成反応に通常用いられる、1,1-カルボニル ジイミダゾール、1,3-ジシクロヘキシルカルボジイ ミド、1-エチル-3-(3-ジメチルアミノプロピ ル)カルボジイミド塩酸塩、クロロギ酸イソブチル又は N-メチルモルホリン等を用いることができる。本反応 は、例えば、−20~50℃で実施することができる。 また当該生成物の基Rcが保護されたアミノ基を含んだ 基である場合には、所望により、当該保護基を慣用の方 法により除去することができる。

【0134】(d法):一般式〔I〕において環A上の置換基が水酸基である目的化合物〔I〕は、環A上の置換基が保護された水酸基である対応化合物〔I〕から当該保護基を除去することにより製することができる。当該保護基の除去は、保護基の種類に応じて酸処理、塩基処理、接触還元等の常法によって実施することができる。本反応は、例えば、0~80℃、とりわけ、5~50℃で好適に進行する。基R¹がアミノ基または低級アルキルアミノ基或いはアミノ基または低級アルキルアミノ基或いはアミノ基または低級アルキルアミノ基を含む置換基である場合は、当該アミノ基に保護基(例えば、tert-ブトキシカルボニル基の如き低級アルコキシカルボニル基、ベンジルオキシカルボニル基等の如きアリール低級アルコキシカルボニル基等の如き低級アルコキシカルボニル基、ホルミル、アセチル基、プロピオニル基等の如き低級アルカノイル基等)を導入してから本反応を実施するのが望まし

【0135】(e法):一般式[I-g] 【0136】 【化33】



【0137】(但し、記号は前記と同一意味を有す

る。) で示される目的化合物のうち、n=1の化合物は、一般式 [I-h]

[0138]

【化34】

【 O 1 3 9 】 (但 し、記号は前記と同一意味を有する。) で示される化合物またはその塩と、一般式〔 V I ー a]

[0140]

【化35】

【 0 1 4 1 】 (但し、記号は前記と同一意味を有する。)で示される化合物またはその誘導体と反応させることにより、製造することができる。

【0142】また、化合物[I-g]のうち、n=0の化合物は、化合物[I-h]またはその塩と、一般式[VI-b]

[0143]

【化36】

$$R^6$$
—Z [VI-b]

【 0 1 4 4 】 (式中、 Z は脱離基を表し、他の記号は前記と同一意味を有する。)で示される化合物を反応させることにより製造することができる。

【0145】化合物〔VI-b〕における脱離基(Z)としては、水酸基、トリフルオロメタンスルホニルオキシ基、pートシルオキシ基、メタンスルホニルオキシ基あるいは塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等のハロゲン原子等が挙げられる。

【0146】化合物 [I-h] と化合物 [VI-a] と の反応は、カルボン酸とアルコールからエステルを製す るのに通常用いられる縮合剤(例えば、1,3-ジシク ロヘキシルカルボジイミド、1-エチル-3-(3-ジ メチルアミノプロピル)カルボジイミド塩酸塩、ジエチ ルリン酸シアニド、ジフェニルリン酸アジド等)の存在 下に実施することができる。化合物[VI-a]の誘導 体(例えば、N-ヒドロキシコハク酸イミドエステル) N-ヒドロキシフタルイミドエステル、1-ヒドロキシ ベンゾトリアゾールエステル等の活性エステル、酸塩化 物、酸臭化物等の酸ハライド)と化合物 [I-h]との 反応は、脱酸剤(例えば、水酸化ナトリウム等の水酸化 アルカリ金属、炭酸水素ナトリウム等の炭酸水素アルカ リ金属、炭酸ナトリウム等の炭酸アルカリ金属、トリエ チルアミン、ピリジン等の有機塩基の存在下に実施する ことができ、所望により、4-ジメチルアミノピリジン

等を触媒量加えてもよい。本反応は、例えば、0~80 ℃、とりわけ、5~60℃で好適に進行する。

【0147】また、化合物〔I-h〕と化合物〔VI-b〕との反応は、脱離基Zが水酸基である場合、例えば、光延等の方法(シンセシス(Synthesis),第1~28頁,1981年)に準じて行うことができる。具体的には、ジエチルアゾジカルボキシレート及びトリフェニルホスフィンの存在下、化合物〔I-h〕と化合物〔VII-b〕をテトラヒドロフラン、ジオキサン、酢酸エチル、ジメチルホルムアミド、クロロホルム、塩化メチレン、ベンゼン、トルエン、ジメトキシエタン等の溶媒中反応させることにより製することができる。本反応は、例えば、0~60℃、とりわけ、5~40℃で好適に進行する。

【0148】さらに、化合物 [I-h] と化合物 [VI -b〕との反応は、化合物 [VI-b]の脱離基が、ト リフルオロメタンスルホニルオキシ基、p-トシルオキ シ基、メタンスルホニルオキシ基、或いは塩素原子、臭 素原子、ヨウ素原子等のハロゲン原子である場合には、 塩基の存在下に実施することができる。本反応は、上記 塩基と銅触媒の存在下或いは非存在下で実施することも 可能である。塩基としては、例えば、水素化ナトリウム 等の如き水素化アルカリ金属、ナトリウムアミド等の如 きアルカリ金属アミド、ナトリウムメトキシド、カリウ ムtertーブトキシド等の如きアルカリ金属アルコキ シド、水酸化ナトリウム等の如き水酸化アルカリ金属、 炭酸ナトリウム等の如き炭酸アルカリ金属等の無機塩基 や、Nーメチルモルホリン、トリエチルアミン、ピリジ ン等の有機塩基を挙げることができる。また、塩基の使 用量としては、化合物 [I-h] に対して、通常1~5 当量、好ましくは、1~2当量用いることができるが、 基R1がモノ置換されていてもよいアミノ基或いはモノ 置換されていてもよいアミノ基を含む置換基である場合 は、当該アミノ基に保護基(例えば、tertーブトキ シカルボニル基の如き低級アルコキシカルボニル基、ベ ンジルオキシカルボニル基等の如きアリール低級アルコ キシカルボニル基、ホルミル、アセチル基、プロピオニ ル基等の如き低級アルカノイル基等)を導入してから本 反応を実施するのが望ましい。

【 0 1 4 9 】銅触媒としては、ヨウ化銅(I)、臭化銅 (I)、銅粉(O)、酸化銅(I)、臭化銅(I I)等 が挙げられる。本反応は、例えば、 1 0~1 6 0℃、と りわけ、20~1 2 0℃で好適に進行する。

【0150】(f法):一般式[I]において基R¹がアミノ基を含有する置換基(例えば、アミノ低級アルキル基等)である目的化合物[I]は、基R¹が保護されたアミノ基を含有する置換基である対応化合物[I]から、アミノ基の保護基を除去することにより製することができる。当該保護基または低級アルカノイル基の除去は常法(例えば、酸処理、塩基処理、接触還元等)によ

って実施することができる。本反応のうち、酸処理による反応は、例えば、 $5\sim120$ $^{\circ}$ 、塩基処理による反応は、 $5\sim40$ $^{\circ}$ 、接触還元による反応は、 $10\sim40$ $^{\circ}$ で実施することができる。

【0151】(g法): -般式[I] において基 R^1 がテトラゾリル基である目的化合物[I] は、基 R^1 がシアノ基である対応化合物[I] と例えば、アジ化ナトリウム、アジ化トリブチルスズ等のアジ化金属を反応させることにより製造することができる。本反応は、例えば、 $30\sim120$ \mathbb{C} 、とりわけ、 $50\sim100$ \mathbb{C} で好適に進行する。

【0152】(h法):一般式〔I〕において基R¹がアミノメチル基である目的化合物〔I〕は、基R¹がシアノ基である対応化合物〔I〕と例えば、適当な触媒及び酸の存在下、溶媒中で水素添加することにより製造することができる。触媒としては、パラジウム、ニッケル等、酸としては、塩化水素、酢酸アンモニウム等が挙げられる。本反応は、例えば、30~120℃、とりわけ、50~100℃で好適に進行する。

【0153】(i 法): 一般式[I] において基 R^1 がヨウ素である目的化合物[I] は、基 R^1 が塩素もしくは臭素である対応化合物[I] と例えば、ヨウ化ナトリウム等をハロゲン交換反応させることにより製造することができる。本反応は、例えば、 $40\sim100$ で好適に進行する。

【0154】(j法):一般式[I]において環Aの置換基がピリジル低級アルケニル基である目的化合物

〔 I 〕は、まず、環Aの置換基が水酸基である対応化合 物〔Ⅰ〕と例えば、トリフルオロメタンスルホン酸無水 物、トリフルオロメタンスルホン酸クロリド等を塩基の 存在下、反応してトリフレート体とし、次いで、該トリ フレート体とピリジル低級アルケニル化合物とを塩基及 び触媒の存在下、反応することにより製造することがで きる。トリフレート体生成反応における塩基としては、 例えば、ピリジン、トリエチルアミン、N-メチルモル ホリン等が好ましい。該反応は、例えば、-20~20 ℃で好適に進行する。また、トリフレート体とピリジル 低級アルケニル化合物との反応における塩基としては、 例えば、トリエチルアミン、炭酸カリウム、酢酸ナトリ ウム、炭酸水素ナトリウム等が好ましい。触媒として は、酢酸パラジウム、ジクロロビス(トリフェニルホス フィン) パラジウム、テトラキス (トリフェニルホスフ ィン)パラジウム等が好ましい。なお、本反応は、添加 物を添加してもよく、該添加物としては、1,1'-ビ ス(ジフェニルホスフィノ)フェロセン、トリオルソホ スフィン、トリフェニルホスフィン等が挙げられる。本 反応は、例えば、60~150℃で好適に進行する。

【0155】(k法):一般式[I]において環Aの置換基がピリジル低級アルキル基である目的化合物[I]は、環Aの置換基がピリジル低級アルケニル基である対

応化合物〔Ⅰ〕を触媒の存在下、水素添加することにより製造することができる。触媒としては、例えば、パラジウムー炭素、パラジウム(黒)等が好ましい。本反応は、例えば、5~50℃で好適に進行する。

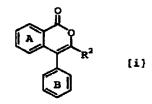
【0156】(1法):一般式〔I〕において基R¹がオキソ基で置換された複素環式基を含有する基(例えば、Nーオキソピリジル基等)である目的化合物〔I〕は、基R¹が複素環式基を含有する基である対応化合物〔I〕を酸化剤(例えば、3-クロロ安息香酸、過酸化水素、過酢酸等)で処理することにより製造することができる。本反応は、例えば、5~50℃で好適に進行する。

【0157】上記(a法)~(1法)に記載の反応に用いる溶媒は、反応を阻害しない溶媒であれば、特に限定されず、例えばジオキサン、エチレングリコールジメチルエーテル、ジメチルアセトアミド、ジメチルホルムアミド、ヘキサメチルホスホラミド、ベンゼン、テトラヒドロフラン、トルエン、酢酸エチル、低級アルコール、塩化メチレン、クロロホルム、四塩化炭素、1,3ージメチルー2ーイミダゾリジノン、酢酸、ジエチルエーテル、ジメトキシエタン、ジメチルスルホキシド、水またはそれらの混合溶媒を適宜選択して用いることができる。

【0158】前記本発明に係る目的化合物〔I〕の製造に際しては、化合物〔I-d〕、〔I-h〕、〔I I〕、〔III〕、〔IV〕、〔VII-a〕及び〔V II-b〕は塩の形でも使用することができ、このような塩としては、例えば、ナトリウム、カリウム、リチウムの如きアルカリ金属塩、ピリジン、トリエチルアミン、Nーメチルモルホリン等の有機塩基との塩、塩化水素、臭化水素、硫酸等の無機酸との塩、酢酸、ギ酸、シュウ酸、クエン酸、マロン酸等の有機酸との塩等が挙げられる。

【0159】原料化合物〔II〕は、例えば、一般式〔i〕

【0160】 【化37】



【0161】(但し、記号は前記と同一意味を有する。)で示されるイソクマリン化合物とアンモニアとを慣用の方法で反応することにより製することができる。【0162】また、原料化合物 [II]のうち、一般式 [II-a]

[0163]

【化38】

【 O 1 6 4 】 (但し、記号は前記と同一意味を有する。)で示されるイソキノリノン化合物は、一般式〔 I I - b 〕

【0165】 【化39】

【0166】(但し、記号は前記と同一意味を有する。)で示されるイソキノリノン化合物と化合物 [VII-a]または化合物 [VII-b]とを上記(e法)と同様に反応することにより製することができる。なお、化合物 [II-b]は、対応する環A上の水酸基を保護基した化合物から、慣用の方法で保護基を除去することにより製することができる。

【0167】なお、イソクマリン化合物〔i〕は、WO 98/38168号記載の方法に準じて製することがで きる。

【0168】なお、本発明において、アルキル基とは、 炭素数1~16のアルキル基を表わし、このうち、とり わけ炭素数1~8の直鎖状又は分岐鎖状のものが好まし い。低級アルキル基、低級アルコキシ基及び低級アルキ レン基とは、炭素数1~6のアルキル基、アルコキシ基 及びアルキレン基を表わし、このうち、とりわけ炭素数 1~4のものが好ましい。ハロゲン原子とは、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素等を表わす。また、低級アルケニル基、低級アルキニル基及び低級アルコキシカルボニル基とは、炭素数2~7のアルケニル基、アルキニル基及びアルコキシカルボニル基を表し、このうち、とりわけ炭素数2~5の直鎖状又は分岐鎖状のものが好ましい。低級アルキレンジオキシ基、低級アルカノイル基とは、炭素数1~7のアルキレンジオキシ基及びアルカノイル基を表し、このうち、とりわけ、炭素数1~5の直鎖状または分岐鎖状のものが好ましい。更に、シクロ低級アルキル基とは、炭素数3~8のシクロアルキル基を表し、このうち、とりわけ炭素数3~6のものが好ましい。

【実施例】上記例示の各方法で合成される本発明の目的 化合物〔I〕の具体例(実施例)を以下に示すが、これ により本発明が限定されるものではない。

【0170】実施例1

[0169]

7-ベンジルオキシー1, 2-ジヒドロー3-メトキシカルボニルー1-オキソー4ー(3, 4, 5-トリメトキシフェニル)イソキノリン1gに、クロロホルム4m1及びオキシ塩化リン4m1を加え30分間加熱還流する。反応液を濃縮した後、残渣に酢酸エチル及びジエチルエーテルを加え、ろ取することにより、7-ベンジルオキシー1-クロロー3-メトキシカルボニルー4ー(3, 4, 5-トリメトキシフェニル)イソキノリン750mgを得る。

[0171] m. p. :159-161°C

実施例2~3

対応原料化合物を実施例1と同様に処理することにより、下記第1表記載の化合物を得る。

[0172]

【表1】

第1表

	CH ₃ O COOCH ₃ CH ₃ O COCH ₃	
実施例番号	環A	物理恒数等
2		m.p.148-150 °C
3		m.p.135-138 °C

【0173】実施例4

実施例1で得られた化合物500mg及びヨウ化ナトリウム3gをアセトニトリル10mlに溶解し、4M塩化水素一酢酸エチル溶液0.2mlを加え、13時間加熱還流する。反応液に、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液及びクロロホルムを加えて抽出し、抽出液を洗浄、乾燥後、溶媒を留去し、残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(溶媒;クロロホルム:アセトン=50:1)で精製することにより、7ーベンジルオキシー1-ヨードー3ーメトキシカルボニルー4ー(3,4,5ートリメトキシフェニル)イソキノリン264mgを得る。

【0174】m. p. :155-157℃ 実施例5

実施例2で得られた化合物を実施例4と同様に処理することにより、1-ヨード-3-メトキシカルボニル-7-(2-ピリジルメトキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)イソキノリンを得る。

【0175】m. p. :156-158℃ 実施例6

7ーベンジルオキシー1,2ージヒドロー3ーメトキシカルボニルー1ーオキソー4ー(3,4,5ートリメトキシフェニル)イソキノリン1.5gをクロロホルムートルエン(1:1)の混合溶媒60mlに溶解し、3ーヨードプロピオン酸ーtertーブチルエステル4.16g及び炭酸銀3.6gを加え、遮光下、70℃で終夜撹拌する。反応液から不溶物をろ去した後、ろ液を濃縮する。残渣に酢酸エチル及び水を加えて抽出し、抽出液を洗浄、乾燥後、溶媒を留去し、残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(溶媒;クロロホルム:ヘキサン:酢酸エチル=2:2:1)で精製することにより、7ーベン

ジルオキシー1-[2-(tert-ブトキシカルボニル) エトキシ] -3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル) イソキノリン1.68 gを得る。

【0176】m. p. :119-121℃ 実施例7

(1) 1, 2-ジヒドロー3-メトキシカルボニルー1 ーオキソー7ー(2-ピリジルオキシ)ー4ー(3, 4, 5-トリメトキシフェニル)イソキノリン220mgと2-ヨードエチルメチルエーテル857mgとを実施例6と同様に処理することにより、3-メトキシカルボニルー1-メトキシエトキシー7ー(2-ピリジルオキシ)-4-(3, 4, 5-トリメトキシフェニル)イソキノリン152mgを得る。

【0177】(2)上記(1)で得られた化合物150mgのクロロホルム5ml溶液に4M塩化水素-ジオキサン溶液0.36mlを加え、氷冷下5分間撹拌する。反応液を濃縮し、残渣にメタノールおよびエーテルを加えて結晶化する。結晶をろ取することにより、3-メトキシカルボニル-1-メトキシエトキシ-7-(2-ピリジルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)イソキノリン・塩酸塩124mgを得る。

【0178】m. p. :179-181℃(分解) 実施例8~22

対応原料化合物を実施例6、または実施例6及び実施例 7(2)と同様に処理することにより、下記第2表及び 第3表記載の化合物を得る。

[0179]

【表2】

	第2表	
	CH ₃ O OCH ₃	
実施例番号	R t	物理恒数等
8	OCH3	m.p.133–135 ℃
9	OCH ₃	m.p.150–151 °C
10	OCH3	m.p. 137–139 °C
.11*	ب	m.p.156–160 ℃
12*	O CH³	m.p.190-193 ℃ (分解)
1 3		m.p.154–156 ℃
14*	O ^{CH} 2	m.p.173-174 ℃ (分解)

*: 1 塩酸塩

【0180】 【表3】

第3表

R ⁷ COOCH ₃ CH ₃ O CH ₃						
実施例番号	R1	R ⁷	R ª	物理恒数等		
15*	,~~	Q.	Н	粉末		
16*	<u>ن</u>	C _N O ₀	Н	m.p.169-173 ℃ (分解)		
17*	OC₂H₅		Н	m.p.172-174 ℃ (分解)		
18		CH3O-	CH30-	m.p. 133–135 °C		
1 9	\\ \-\\ \\ \-\	CH3O-	CH ₃ O-	m.p. 156–158 ℃		
20*	2 0 * CH ₃ O- CH ₃ O- m.p. 164-165 °C					
21*		CH3O-	CH ₃ O~	m.p.183-185 °C		
22*	o N	CH3O-	СН3О-	m.p.205-208 ℃ (分解)		

*: 1 塩酸塩

【0181】実施例23

7ーベンジルオキシー1,2ージヒドロー3ーメトキシカルボニルー1ーオキソー4ー(3,4,5ートリメトキシフェニル)イソキノリン290mg、3,5ージメトキシベンジルアルコール159mg及びトリフェニルホスフィン496mgをテトラヒドロフラン40mlに溶解した後、アゾジカルボン酸ジエチル298μlを加えて、室温で10分間撹拌する。反応液から溶媒を留去し、残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(溶媒:クロロホルム:ヘキサン:酢酸エチル=5:5:1)で精製することにより、7ーベンジルオキシー1ー(3,5ー

ジメトキシベンジルオキシ) -3 - メトキシカルボニル -4 - (3, 4, 5 - トリメトキシフェニル) イソキノリン 44 m g を 得る。

m. p. : 165-168℃

実施例24~31

対応原料化合物を実施例23、または実施例23及び実施例2(2)と同様に処理することにより、下記第4表記載の化合物を得る。

[0182]

【表4】

黛 4 夷

第 4 表					
	R^7 $COOCH_3$ CH_3OOCH_3 OCH_3				
実施例番号	R 1	R ⁷	物理恒数等		
2 4 *	O N	Qa	m.p.147-150 ℃ (分解)		
25*	O CH	N O	m.p. 188-190 ℃ (分解)		
26**	O NH₂		粉末		
27**		Q.o.	粉末		
28**	ŶŶŶŊ.	Q_{N}	m.p.232-234 ℃ (分解)		
29**		Q _N O ₁	m.p.148-150 ℃ (分解)		
3 0	N CH3 CH3	Qa	未精製		
3 1	O CH ₃ CH ₃	Q_{N}	m.p.122-130 ℃ (分解)		

*: 1 塩酸塩 **: 2 塩酸塩

【0183】実施例32

(1) 7-ベンジルオキシー1-クロロー3-メトキシ カルボニルー4ー(3,4,5ートリメトキシフェニ ル) イソキノリン150mg及び2-(ジメチルアミ **ノ) エタノール29.8mgをジメチルホルムアミド6** m1に溶解し、水素化ナトリウム12.8mgを加え、 室温で3時間撹拌する。さらに反応液に2-(ジメチル アミノ) エタノール59.6 mg及び水素化ナトリウム 25.6mgを加え、室温で3時間撹拌後、トリエチル アミン塩酸塩334mg、メタノール3m1及びトリメ チルシリルジアゾメタン(2Mへキサン溶液)2.04 m1を加え、室温で1時間撹拌する。反応液に酢酸エチ ル及び水を加えて抽出し、抽出液を洗浄、乾燥後、溶媒 を留去する。残渣をNH-シリカゲルクロマトグラフィ - (溶媒; ヘキサン: 酢酸エチル=2:1) で精製する ことにより、7ーベンジルオキシー1ー〔2ー(ジメチ ルアミノ) エトキシ〕-3-メトキシカルボニル-4(3,4,5-トリメトキシフェニル) イソキノリンを 得る。

【0184】(2)上記(1)で得られた化合物のクロロホルム2m1溶液に4M塩化水素-酢酸エチル溶液228μ1を加え、室温で5分間撹拌する。反応液を濃縮し、残渣にジエチルエーテルを加え、ろ取することにより、7ーベンジルオキシー1ー〔2ー(ジメチルアミノ)エトキシ〕-3ーメトキシカルボニルー4ー(3,4,5ートリメトキシフェニル)イソキノリン・塩酸塩41.7mgを得る。

【0185】m. p. :221-224℃(分解) 実施例33~46

対応原料化合物を実施例32(1)、または実施例32 (1)及び(2)と同様に処理することにより、下記第 5表及び第6表記載の化合物を得る。

[0186]

【表5】

第5表

R ⁷ COOCH ₃ COCH ₃ OCH ₃				
実施例番号	R¹	R ⁷	物理恒数等	
3 3	о соосн₃	Qa	m. p. 155–157 °C	
3 4 *	ONH NH	C _N C _O C	m.p.171-175 ℃ (分解)	
35*	ON CH ₃	Q.o.	m.p.186-189 ℃ (分解)	
36*	-0CH ₃	Q.o.	m.p.186–188 ℃ (分解)	
37*	Ç	(No.	m.p.158–161 ℃ (分解)	
38*			粉末	
39**			m.p.153-155 ℃ (分解)	
40**		C _N o .	m.p.152-154 ℃ (分解)	

*:1塩酸塩 **:2塩酸塩

[0187]

【表6】

第6表

87 U 32						
	CH ₃ O COOCH ₃					
実施例番号	R 1	R 7	物理恒数等			
41**	ŶŢN	Q.o.	m.p.171-173 ℃ (分解)			
42**	o CH³		m.p.187-190 ℃ (分解)			
43**	OCH3	C _N C _O	m.p.153-156 ℃ (分解)			
44**	O CH ₃	Q _N o.	m.p.191-198 ℃ (分解)			
45*	OCH ³	C _N Z _o	m.p. 184-190 ℃ (分解)			
4 6	O OH	Qa	m.p. 172–173 °C			

*: 1 塩酸塩 **: 2 塩酸塩

【0188】実施例47

 α ートルエンチオール120 μ 1をジメチルホルムアミド5m1に溶解し、水素化ナトリウム40mgを加え、室温で30分間撹拌する。反応液に、7-ベンジルオキシー1-クロロー3-メトキシカルボニルー4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)イソキノリン250mgのジメチルホルムアミド5m1溶液を加え、室温で1時間撹拌する。反応液に、水を加え酢酸エチルで抽出し、抽出液を洗浄、乾燥後、溶媒を留去する。残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(溶媒;ヘキサン:酢酸エチル=3:1)で精製することにより、7-ベンジルオキシー1-ベンジルチオー3-メトキシカルボニルー4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)イソキノリン233mgを得る。

【0189】m. p. :143-145℃ 実施例48

チオフェノールと 7 ーベンジルオキシー 1 ークロロー3 ーメトキシカルボニルー4ー(3,4,5ートリメトキシフェニル)イソキノリンとを実施例47と同様に処理することにより、7 ーベンジルオキシー3 ーメトキシカルボニルー1 ーフェニルチオー4 ー(3,4,5ートリメトキシフェニル)イソキノリンを得る。

【0190】m. p. :134-136℃

実施例49

(1)1-クロロー3-メトキシカルボニル-7-(2ーピリジルメトキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)イソキノリン150mgと3,5-ジメトキシアニリン348mgを130℃で2時間撹拌する。反応液を室温まで冷却した後、酢酸エチルを加えて、洗浄、乾燥後、溶媒を留去する。残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(溶媒;ヘキサン:酢酸エチル=1:1)で精製することにより、1-(3,5-ジメトキシフェニルアミノ)-3-メトキシカルボニル-7-(2-ピリジルメトキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)イソキノリン111mgを得る。

[0191] m. p. :164-166℃

(2)上記(1)で得られた化合物100mgの塩化メチレン1.5ml溶液に、氷冷下、4M塩化水素-酢酸エチル溶液120μlを加える。析出した結晶を酢酸エチルで洗浄することにより、1-(3,5-ジメトキシフェニルアミノ)-3-メトキシカルボニル-7-(2-ピリジルメトキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)イソキノリン・2塩酸塩100mgを得る。

【0192】m. p. :172-176℃ 実施例50~57 対応原料化合物を実施例49(1)、または実施例49

[0193]

(1)及び(2)と同様に処理することにより、下記第

【表7】

7表及び第8表記載の化合物を得る。

第7表

	第7表	
	CH ₃ O COOCH ₃	
実施例番号	R ¹	物理恒数等
50**	HN OCH ₃	粉末
51**	HN OCH3	粉末
5 2	HN OCH3	m.p. 178–180 ℃
53**	HN OCH3	m.p.170–174 ℃
5 4 **	HN OCH3	粉末

**: 2 塩酸塩

[0194]

【表8】

第8赛

: 2 塩酸塩

【0195】実施例58

(1) 7-ベンジルオキシ-1-クロロ-3-メトキシ カルボニルー4ー(3,4,5-トリメトキシフェニ ル) イソキノリン1gのジメチルホルムアミド10ml 溶液に、ジエチルー3ーピリジルボラン343mg、酢 酸パラジウム45mg、トリーortho-トルイルホ スフィン122mg及び3M炭酸ナトリウム水溶液1m 1を加え、アルゴン雰囲気下、90℃で1時間撹拌す る。反応液を室温まで冷却し、不溶物をろ去後、ろ液に 酢酸エチル及び水を加え抽出する。抽出液を洗浄、乾燥 後、溶媒を留去し、残渣をシリカゲルクロマトグラフィ ー(溶媒;クロロホルム:ヘキサン:酢酸エチル=5: 5:2からクロロホルム:アセトン=10:1)で精製 することにより、粉末状の(a)7-ベンジルオキシー 1-エチル-3-メトキシカルボニル-4-(3,4, 5-トリメトキシフェニル) イソキノリン86mg及び 粉末状の(b) 7ーベンジルオキシー3ーメトキシカル

ボニルー1ー(3ーピリジル)ー4ー(3,4,5ートリメトキシフェニル)イソキノリン959mgを得る。【0196】(2)上記(1)で得られた化合物(b)70mgのクロロホルム1ml溶液に、4M塩化水素ージオキサン溶液32.6μlを加え、室温で5分間撹拌する。反応液を濃縮し、残渣にアセトンを加え、ろ取することにより、7ーベンジルオキシー3ーメトキシカルボニルー1ー(3ーピリジル)ー4ー(3,4,5ートリメトキシフェニル)イソキノリン・塩酸塩56mgを得る。

【0197】m. p. :188-192℃(分解) 実施例59~67

対応原料化合物を実施例58(1)、または実施例58 (1)及び(2)と同様に処理することにより、下記第 9表及び第10表記載の化合物を得る。

[0198]

【表9】

第9表

CH ₃ O OCH ₃					
実施例番号	R¹	R '	物理恒数等		
5 9	CH3O OCH3	0,0,	m.p.189~191 °C		
60**			m.p. 151-159 ℃ (分解)		
61**	_z_	Q.o.	m.p.120-125 ℃ (分解)		
62**		Q_{N} $\circ \sim$	m.p.176–183 ℃ (分解)		
6 3	N	Qa	m.p.182-184 °C		
6 4	NYN	Q_o_o_	m.p.185-186 °C		
6 5	N N	0.0	m.p.208-209 °C		

: 2 塩酸塩

[0199]

【表10】

第10表

CH ₃ O COOCH ₃ CH ₃ O COCH ₃					
実施例番号	R¹	環A	物理恒数等		
6 6 °	N N		m.p. 159–161 °C		
6 7	_{z}	O'è	m.p. 175–176 °C		

*:1塩酸塩

【0200】実施例68

7-ベンジルオキシ-1-クロロ-3-メトキシカルボ

ニルー4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)イソ キノリン20gのジメチルホルムアミド200m1溶液 に、トルエンスルホン酸ナトリウム15.5g及びシアン化カリウム17gを加え、140℃で9時間撹拌する。反応液を室温まで冷却後、ヨードメタン22m1及び炭酸カリウム9gを加え、終夜撹拌する。反応液から溶媒を留去後、水、酢酸エチル及びヘキサンを加え抽出し、抽出液を洗浄、乾燥後、溶媒を留去する。残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(溶媒;クロロホルム:酢酸エチル=50:1)で精製することにより、7ーベンジルオキシー1ーシアノー3ーメトキシカルボニルー4ー(3,4,5ートリメトキシフェニル)イソキノリン17.8gを得る。

【0201】m. p. :186-187℃ 実施例69

1-クロロー3-メトキシカルボニル-7-(2-ピリジルメトキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)イソキノリシとシアン化カリウムとを実施例68と同様に処理することにより、1-シアノ-3-メトキシカルボニル-7-(2-ピリジルメトキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)イソキノリンを得る。

【0202】m. p. :214-215℃ 実施例70

(1)実施例4で得られた化合物250mg、1-アミノー4-メチルピペラジン147μ1、酢酸パラジウム30mg、炭酸セシウム627mg及び1,1'-ビス(ジフェニルホスフィノ)フェロセン69mgをトルエン2.5m1に溶解し、100℃で2時間撹拌する。反応液をろ過し、不溶物を除去後、溶媒を留去し、残渣をNHーシリカゲルクロマトグラフィー(溶媒;クロロホルム)で精製することにより、7-ベンジルオキシー3-メトキシカルボニルー1-(4-メチルピペラジンー1-イルアミノ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)イソキノリン120mgを得る。

【0203】(2)上記(1)で得られた化合物120mgの酢酸エチル2ml溶液に、4M塩化水素-酢酸エチル溶液52μlを加え、室温で5分間撹拌する。反応液を濃縮し、残渣にジエチルエーテルを加え、ろ取することにより、7ーベンジルオキシー3ーメトキシカルボニルー1ー(4ーメチルピペラジンー1ーイルアミノ)ー4ー(3,4,5ートリメトキシフェニル)イソキノリン・塩酸塩95mgを得る。

【0204】m. p. :160-162℃(分解) 実施例71

1-ヨード-3-メトキシカルボニル-7-(2-ピリジルメトキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)イソキノリンとモルホリノアミンとを実施例70

(1)及び(2)と同様に処理することにより、3-xトキシカルボニル-1-Eルホリノアミノ-7-(2-E)リジルメトキシ)-4-(3,4,5-E)フェニル)イソキノリンを得る。

【0205】m. p. :234-237℃(分解) 実施例72

(1)実施例5で得られた化合物178mg、2-ヒド ロキシピリジン57mg、炭酸カリウム84mg、ヨウ 化銅116mgをジメチルホルムアミド4mlに溶解 し、120℃で1時間撹拌する。反応液に飽和アンモニ ア水溶液および酢酸エチルを加え抽出し、抽出液を洗 浄、乾燥後、溶媒を留去する。残渣をシリカゲルクロマ トグラフィー(溶媒;クロロホルム:アセトン=50: 1)で精製することにより、3-メトキシカルボニルー 1-(2-オキソー2H-ピリジン-1-イル)-7-トキシフェニル) イソキノリン178mgを得る。 【0206】(2)上記(1)で得られた化合物178 mgを実施例70(2)と同様に処理することにより、 3-メトキシカルボニル-1-(2-オキソ-2H-ピ リジン-1-イル)-7-(2-ピリジルメトキシ)-4-(3, 4, 5-トリメトキシフェニル) イソキノリ ン・2塩酸塩116mgを得る。

【0207】m.p.:190-194℃(分解) 実施例73

7-ベンジルオキシー1-クロロー3-メトキシカルボニルー4ー(3,4,5-トリメトキシフェニル)イソキノリン50mgのイソプロパノール5ml溶液に、4ーヒドロキシピペリジン100mgを加え、2時間加熱還流する。反応液から溶媒を留去後、水及びクロロホルムを加え抽出し、抽出液を洗浄、乾燥後、溶媒を留去する。残渣をNH-シリカゲルクロマトグラフィー(溶媒;ヘキサン:クロロホルム=1:1)で精製することにより、無色油状の7-ベンジルオキシー1-(4-ヒドロキシピペリジン-1-イル)-3-メトキシカルボニルー4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)イソキノリン35mgを得る。

【0208】実施例74~92

7-ベンジルオキシー1-クロロー3-メトキシカルボニルー4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)イソキノリンと対応原料化合物とを実施例73と同様に処理することにより、下記第11~13表記載の化合物を得る。

[0209]

【表11】

쫥	1	1	実

	COOCH ₃	
実施例番号	CH ₃ O OCH ₃	物理恒数等
失施切番号 7 4 **	CH ₃	粉末
75**	N N	粉末
76	Ç	m.p.185-186 °C
77		m.p. 127−128 ℃
7 8	\rangle \rangl	m.p.163 ℃
7 9	N OH	m.p.144-150 °C

**: 2 塩酸塩

[0210]

【表12】

-	•	~	#
弗	1		302

第 1 2 交			
	CH ₃ O CCH ₃	·	
実施例番号	R¹	物理恒数等	
8 0	N _{OH}	m.p. 143–145 ℃	
8 1	, ОН	m.p.112–125 ℃	
8 2	N H	m.p.146–149 ℃	
8 3	N OH	m.p.78–90°C	
8 4	, OH	m.p.67-70 ℃	
8 5	N OH	m.p.81−84 °C	

【0211】 【表13】

第13表

【0212】実施例93

7-ベンジルオキシー1-クロロー3-メトキシカルボニルー4ー(3,4,5-トリメトキシフェニル)イソキノリン100mg、2-アミノエチルメチルエーテル2ml及び酸化銅(I)50mgを3時間加熱還流する。反応液を水にあけ、酢酸エチルを加え抽出し、抽出液を洗浄、乾燥後、溶媒を留去する。残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(溶媒:クロロホルム:酢酸エチル=19:1)で精製することにより、無色油状の7-ベンジルオキシー3-メトキシカルボニルー1-(2-メ

トキシエチルアミノ) -4-(3, 4, 5-トリメトキシフェニル) イソキノリン<math>50mgを得る。

【0213】m. p. :200-202℃(分解) 実施例94~101

7ーベンジルオキシー1ークロロー3ーメトキシカルボニルー4ー(3,4,5ートリメトキシフェニル)イソキノリンと対応原料化合物とを実施例93と同様に処理することにより、下記第14表記載の化合物を得る。

[0214]

【表14】

第14表

	第14表		
CH ₃ O OCH ₃			
実施例番号	R'	物理恒数等	
94*	ни ОСН3	m.p.191-193 °C (分解)	
9 5	HN N	m.p.139–141 °C	
96*	HN	m.p.194-197 ℃ (分解)	
97**	HN	粉末	
98**	HN	m.p.160-162 ℃ (分解)	
99*	HN C1	m.p.150-155 ℃ (分解)	
100**	HN	m.p. 136–139 °C	
101	HNNNNN	m.p.143–146 ℃	
** 1 / 1 1 1 1 1 1 1 1 1	**・ 2 特施行		

*: 1 塩酸塩 **: 2 塩酸塩

【0215】実施例102

(1) 7-ベンジルオキシー1-クロロー3-メトキシカルボニルー4ー(3,4,5-トリメトキシフェニル)イソキノリン300mg、tertーブトキシカルボニルヒドラジン201mg、酢酸パラジウム27mg、炭酸セシウム594mg及び1,1'ービス(ジフェニルホスフィノ)フェロセン65mgをトルエン3m1に溶解し、100℃で30分間撹拌する。反応液をろ過し、不溶物を除去後、溶媒を留去し、残渣をNHーシリカゲルクロマトグラフィー(溶媒;ヘキサン:酢酸エチル=1:1)で精製することにより、7-ベンジルオキシー1-(N'-tert-ブトキシカルボニルヒドラジノ)-3-メトキシカルボニルー4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)イソキノリン189mgを得る。

【0216】(2)上記(1)で得られた化合物189mgの酢酸エチル2m1溶液に、4M塩化水素-酢酸エチル溶液80μ1を加え、室温で5分間撹拌する。反応

液を濃縮し、残渣にジエチルエーテルを加え、ろ取することにより、7ーベンジルオキシー1ー(N'-tert-ブトキシカルボニルヒドラジノ)ー3ーメトキシカルボニルー4ー(3,4,5ートリメトキシフェニル)イソキノリン・塩酸塩157mgを得る。

【0217】m. p. :190-193℃(分解) 実施例103

実施例6で得られた化合物1.6gをクロロホルム15m1に溶解し、4m塩化水素ージオキサン溶液10m1を加えて、室温で4時間撹拌する。反応液に飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加え、アルカリ性にした後、酢酸エチルを加え、水層と有機層に分ける。該有機層に飽和炭酸ナトリウム水溶液を加えて洗浄し、当該水層を先に得られた水層と合する。該水層に、クエン酸水溶液を加えて酸性とした後、酢酸エチルを加え抽出する。抽出液を洗浄、乾燥後、溶媒を留去し、残渣にジエチルエーテル及びヘキサンを加え、ろ取することにより、7ーベンジルオキシー1-(2-カルボキシエトキシ)-3-メ

トキシカルボニル-4-(3, 4, 5-トリメトキシフェニル) イソキノリン740mgを得る。

【0218】m. p. :133-134℃

実施例104

実施例31で得られた化合物を実施例103と同様に処理することにより、粉末状の1-(2-カルボキシエトキシ)-3-メトキシカルボニル-7-(2-ピリジルメトキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)イソキノリンを得る。

【0219】実施例105

実施例103で得られた化合物100mgのジメチルホルムアミド1ml溶液に、1-ヒドロキシベンゾトリアゾール・1水和物31mg及び1-(3-ジメチルアミノプロピル)-3-エチルカルボジイミド・塩酸塩38mgを加え、15分間撹拌する。モルホリン17μ1を

加え、30分間撹拌した後、酢酸エチル及び飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加えて抽出する。抽出液を洗浄、乾燥後、溶媒を留去し、残渣にジイソプロピルエーテル及びヘキサンを加え、ろ取することにより、7ーベンジルオキシー1ー{〔2-(4-モルホリノ)カルボニル〕エトキシ}-3-メトキシカルボニルー4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)イソキノリン85mgを得る。

【0220】m.p.:179-181℃ 実施例106~109

対応原料化合物を実施例105と同様に処理することにより、下記第15表記載の化合物を得る。

[0221]

【表15】

第15表 COOCH, CH₂O осн3 実施例番号 R⁷ R ' 物理恒数等 106 m.p. 147-149 ℃ 107 CONH₂ m.p. 184-185 ℃ 108 m.p. 153-154 ℃ ĊН3 CONH₂ 粉末 109*

*: 1 塩酸塩

【0222】実施例110

実施例58(1)で得られた化合物(b)889mgのテトラヒドロフランーメタノール(1:1)混合溶液20mlに10%パラジウムー炭素60mgを加え、水素雰囲気下(1気圧)、室温で3時間撹拌する。パラジウムー炭素をろ去した後、ろ液を濃縮し、残渣にジイソプロピルエーテルを加え、ろ取することにより、7ーヒドロキシー3ーメトキシカルボニルー1-(3-ピリジ

 ν) -4-(3,4,5-トリメトキシフェニ ν) イソキノリン666mgを得る。

[0223] m. p. :201-203℃

実施例111~114

対応原料化合物を実施例110と同様に処理することにより、下記第16表記載の化合物を得る。

[0224]

【表16】

第16表

CH ₃ O OCH ₃			
実施例番号	環A	R¹	物理恒数等
111	но	N OH	粉末
112	но	N OH	粉末
113	но	HN N	粉末
114	OH OH		m.p.214−216 ℃

【0225】実施例115

実施例110で得られた化合物150mg、ピラジンメタノール56mg及びトリフェニルホスフィン133mgをテトラヒドロフラン2m1に溶解した後、アゾジカルボン酸ジエチル80μ1を加えて、室温で10分間撹拌する。反応液から溶媒を留去し、残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(溶媒;クロロホルム:アセトン=2:3)で精製することにより、3-メトキシカルボニルー7ーピラジニルメトキシ1ー(3ーピリジル)ー4ー(3,4,5-トリメトキシフェニル)イソキノリンを得る。

【0226】(2)上記(1)で得られた化合物を塩化メチレン1mlに溶解し、4M塩化水素ージオキサン溶

液 75μ 1を加えて撹拌した後、溶媒を留去する。残渣にアセトンを加え、ろ取することにより、3-メトキシカルボニル-7-ピラジニルメトキシ1-(3-ピリジル)-4-(3, 4, 5-トリメトキシフェニル) イソキノリン・塩酸塩88mgを得る。

【0227】m. p. :179-188℃(分解) 実施例116~129

対応原料化合物を実施例115(1)および(2)と同様に処理することにより、下記第17表及び第18表記載の化合物を得る。

[0228]

【表17】

33	1	7	蛙
983	•	•	10c

CH ₃ O OCH ₃				
実施例番号	R 7	物理恒数等		
116*	€ ^N L,o	m.p.175-178 ℃ (分解)		
117*	CH3O	粉末		
118*	СН³О СН³О	粉末		
119 [™]	CH ₃ ~N~O~	m.p.165-169 ℃ (分解)		
120**	0 N 0 0	m.p.148–155 ℃ (分解)		
121**	HN	m.p. 175–178 ℃ (分解)		
1 2 2**	⟨N~°°	m.p.162-167 ℃ (分解)		
1 2 3**	Cn~o~	粉末		
*・1 右動作	ack・ 2 作画的行			

*: 1 塩酸塩 **: 2 塩酸塩

[0229]

【表18】

第18表

	第1030	
	CH ₃ O OCH ₃	
実施例番号	環A	物理恒数等
1 2 4 **	CH ₃	粉末
1 2 5***	NH NO C	m.p.216-219 ℃ (分解)
126**	HO	粉末
127**		m.p.222-224 ℃ (分解)
128*	CH ₃ O	m.p.123-128 ℃ (分解)
1 2 9		m. p. 220–221 °C
** 1 恒 产 位	**・2 恒酸恒 ***: 3 塩酸塩	

*: 1 塩酸塩

**: 2 塩酸塩

***: 3 塩酸塩

【0230】実施例130

(1) 実施例111で得られた化合物132mgのジメチルホルムアミド溶液10mlに、炭酸カリウム110mg及び2-ピコリルクロリド・塩酸塩66mgを加えて、60℃で3時間撹拌する。反応液に水及び酢酸エチルを加え抽出し、抽出液を洗浄、乾燥後、溶媒を留去する。残渣をNH-シリカゲルクロマトグラフィー(溶媒;クロロホルム)で精製することにより、1-(4-ヒドロキシピペリジン-1-イル)-3-メトキシカルボニル-7-(2-ピリジルメトキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)イソキノリンを得る。【0231】(2)上記(1)で得られた化合物をメタノール5mlに溶解し、10%塩化水素-メタノール溶

液1mlを加えて撹拌した後、溶媒を留去する。残渣に ジエチルエーテルを加えてろ取することにより、1-(4-ヒドロキシピペリジン-1-イル)-3-メトキ シカルボニル-7-(2-ピリジルメトキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)イソキノリン・ 2塩酸塩73mgを得る。

【0232】実施例131~132

対応原料化合物を実施例130(1)、または実施例130(1)及び(2)と同様に処理することにより、下記第19表記載の化合物を得る。

[0233]

【表19】

第19赛

**: 2 塩酸塩

【0234】実施例133

(1)実施例68で得られた化合物18gのテトラヒドロフランーメタノール(1:1)混合溶液300mlに、10%パラジウムー炭素18gを加え、水素雰囲気下(3.5気圧)、室温で1時間撹拌した後、4M塩化水素ージオキサン16.2mlを加え、室温で7時間撹拌する。パラジウムー炭素をろ去した後、ろ液を濃縮することにより、1ーアミノメチルー7ーヒドロキシー3ーメトキシカルボニルー4ー(3,4,5ートリメトキシフェニル)イソキノリンを得る。

【0235】(2)上記(1)で得られた化合物の塩化メチレンージメチルホルムアミド(5:1)混合溶液240mlに、トリエチルアミン15.7ml及びジーセertーブチルージカルボナート10.6gを氷冷下加えて、室温で終夜撹拌する。反応液から溶媒を留去した後、残渣に10%クエン酸水溶液及び酢酸エチルを加え抽出する。抽出液を洗浄、乾燥後、溶媒を留去する。残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(溶媒;クロロホルム:酢酸エチル=8:1)で精製することにより、油状の1-(tertーブトキシカルボニルアミノメチル)-7-ヒドロキシー3ーメトキシカルボニルー4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)イソキノリンを得る。

【0236】(3)上記(2)で得られた化合物を実施例133(1)と同様に処理することにより、1-(tert-ブトキシカルボニルアミノメチル)-3-メトキシカルボニル-7-(2-ピリジルメトキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)イソキノリン9.0gを得る。

[0237] m. p. : 176-177%

実施例134

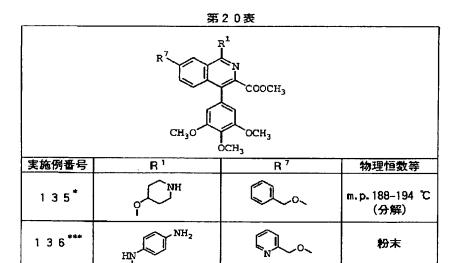
実施例133(3)で得られた化合物8.7gのジオキサン溶液100mlに、氷冷下、4M塩化水素-ジオキサン200mlを加え、10分間撹拌し、次いで室温で1時間撹拌する。反応液にジエチルエーテル600mlを加え、析出した結晶をろ取することにより、1-アミノメチル-3-メトキシカルボニル-7-(2-ピリジルメトキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)イソキノリン・3塩酸塩8.0gを得る。

【0238】m. p. :222-224℃(分解) 実施例135~136

対応原料化合物を実施例134と同様に処理することにより、下記第20表記載の化合物を得る。

[0239]

【表20】



*: 1 塩酸塩 ***: 3 塩酸塩

【0240】実施例137

(1)実施例134で得られた化合物500mgのジメチルホルムアミド溶液10mlに、3ーピリジルカルボン酸154mg、ジイソプロピルエチルアミン582 μ 1及び1-(3-ジメチルアミノプロピル)-3-エチルカルボジイミド・塩酸塩240mgを加え、室温で3時間撹拌する。析出した結晶をろ取し、該結晶をシリカゲルクロマトグラフィー(溶媒;クロロホルム:メタノール=10:1)で精製することにより、3-メトキシカルボニルー1-(3-ピリジルメトキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)イソキノリン345mgを得る。

[0241] m. p. :233-234℃

(2)上記(1)で得られた化合物86mgを実施例1 15(2)と同様に処理することにより、3-メトキシカルボニルー1-(3-ピリジルカルボニルアミノメチル)-7-(2-ピリジルメトキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)イソキノリン・3塩酸塩92mgを得る。

【0242】m. p. :155-158℃(分解) 実施例138~149

対応原料化合物を実施例137(1)、または実施例137(1)及び(2)と同様に処理することにより、下記第21表及び第22表記載の化合物を得る。

[0243]

【表21】

327	2	٩	Æ
æ	~	-1	20

CH ₃ O OCH ₃			
	осн,	AL 700 1 - W. Ad-	
実施例番号	R ¹	物理恒数等	
138	CNHCOCH³	m.p.152-154 °C	
139***	L H N	粉末	
140	H	m.p.215-216 ℃	
1 4 1	H	m.p.204-205 °C	
1 4 2	CH ₂	m.p. 131-132 °C	
143	H NH ₂	m.p.265-266 ℃ (分解)	
144	O CH ₃	m.p.222-224 ℃	

*** : 3 塩酸塩

[0244]

【表22】

第22表

第22 较			
CH ₃ O OCH ₃			
実施例番号	R'	R 7	物理恒数等
1 4 5	H	Q.o.	m.p.259–260 ℃
1 4 6	H CH3	C _N C ₀	m.p.201-202 °C
1 4 7	H CH ₃		m.p.169-170 °С
1 4 8	C1		m.p. 1 64 –166 ℃
149	МНСОСН₃	٥	m.p. 177–179 ℃

【0245】実施例150

実施例68で得られた化合物150mgのジメチルホルムアミド3m1溶液に、塩化アンモニウム83mg及びアジ化ナトリウム101mgを加え、70℃で2日間撹拌する。室温まで冷却した後、酢酸エチル及び水を加えて抽出する。抽出液を洗浄、乾燥後、溶媒を留去し、残渣にジエチルエーテル及び酢酸エチルを加え、ろ取することにより、7-ベンジルオキシー3-メトキシカルボニルー1-(5-テトラゾリル)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)イソキノリン105mgを得る。

【0246】m. p. :230-237℃(分解) 実施例151

実施例1で得られた化合物200mg、3-メトキシプロピルアミン200mg及び炭酸カリウム60mgのイソプロピルアルコール溶液2m1を20時間、加熱還流する。反応液を水に注ぎ、酢酸エチルを加え抽出し、抽出液を洗浄、乾燥後、溶媒を留去する。残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(溶媒;酢酸エチル:へキサン=1:4)で精製することにより、(a)7-ベンジルオキシー1-クロロー3-イソプロポキシカルボニルー4ー(3、4、5-トリメトキシフェニル)イソキノリン

 $115 m g 及 び (b) 7 - ベンジルオキシー 3 - イソプロポキシカルボニルー <math>1 - (3 - \lambda k + \lambda b)$ つピルアミノ) -4 - (3, 4, 5 - k b) メトキシフェニル) イソキノリン 46 m g を得る。

【0247】(a) m. p. :159-161℃

(b) m. p. : 145-147°C

実施例152

(1)実施例1で得られた化合物116mg及び水酸化カリウム52mgの水ーメタノール混合溶液(1:9)10mlを3時間、加熱還流する。反応液に水を加え、塩酸で反応液をpH2~3に調整した後、酢酸エチルを加え抽出する。抽出液を洗浄、乾燥後、溶媒を留去することにより、7ーベンジルオキシー1ークロロー4ー(3,4,5ートリメトキシフェニル)イソキノリンー3ーカルボン酸102mgを得る。

【0248】m. p. :153-155℃

(2)上記(1)で得られた化合物70mg、2-アミノエタノール1ml及び炭酸カリウム30mgの2-メトキシエタノール1ml溶液を130℃で20時間撹拌する。反応液を水に注ぎ、クエン酸水溶液で中和した後、酢酸エチルを加え抽出する。抽出液を洗浄、乾燥後、溶媒を留去することにより、7-ベンジルオキシー

5-トリメトキシフェニル) イソキノリン-3-カルボ ン酸を得る。

【0249】(3)上記(2)で得られた化合物のメタ ノールー濃硫酸混合溶液(10:1)33m1を20時 間、加熱還流する。反応液を水に注ぎ、酢酸エチルを加 え抽出し、抽出液を洗浄、乾燥後、溶媒を留去する。残 渣をシリカゲルクロマトグラフィー(溶媒;クロロホル ム:メタノール=20:1)で精製することにことによ り、7-ベンジルオキシー1-(2-ヒドロキシエチル

アミノ) -3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5 -トリメトキシフェニル) イソキノリン19.3mgを 得る。

[0250] m. p. :143-146°C

実施例153~154

実施例152(1)で得られた化合物と対応原料化合物 とを実施例152(2)及び(3)と同様に処理するこ とにより、下記第23表記載の化合物を得る。

[0251]

【表23】

第23表 COOCH, OCH, ÓCH₃ 実施例番号 物理恒数等 ÇH₃ 153 m. p. 143–147 ℃ (分解) ÇH₃

CH2

【0252】実施例155 実施例1で得られた化合物200mg、2-(メチルア ミノ)エタノール200mg及び炭酸カリウム69mg のイソプロピルアルコール溶液2m1を18時間、加熱 還流する。反応液を炭酸水素ナトリウム水溶液に注ぎ、 酢酸エチルを加え抽出し、抽出液を洗浄、乾燥後、溶媒 を留去する。残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(溶 媒;クロロホルム:メタノール=50:1)で精製する ことにより、粉末状の(a) 7-ベンジルオキシー1-クロロ-3-(N-(2-ヒドロキシエチル)-N-メ チルカルバモイル〕-4-(3,4,5-トリメトキシ フェニル)イソキノリン96.9mg及び粉末状の (b) 7-ベンジルオキシ-3-[N-(2-ヒドロキ シエチル) - N - メチルカルバモイル] - 1 - [N -(2-ヒドロキシエチル)-N-メチルアミノ]-4-(3, 4, 5-トリメトキシフェニル) イソキノリン7 6.3mgを得る。

154

【0253】実施例156

実施例1で得られた化合物200mg、ジエタノールア ミン270mg及び炭酸カリウム60mgのイソプロピ ルアルコール溶液2mlを18時間、加熱還流する。反 応液を炭酸水素ナトリウム水溶液に注ぎ、酢酸エチルを 加え抽出し、抽出液を洗浄、乾燥後、溶媒を留去する。

残渣をNH-シリカゲルクロマトグラフィー(溶媒:ク ロロホルム:メタノール=50:1)で精製することに より、粉末状の7-ベンジルオキシ-1-〔N.N-ジ (2-ヒドロキシエチル)カルバモイル〕-4-(3, 4,5-トリメトキシフェニル)イソキノリン90.2 mgを得る。

粉末

【0254】実施例157

実施例1で得られた化合物65mgとアミノメチルシク ロヘキサン1mlとを実施例162と同様に処理するこ とにより、7-ベンジルオキシー1-(シクロヘキシル メチルアミン) -3- (シクロヘキシルメチルカルバモ イル)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)イ ソキノリン22mgを得る。

【0255】m.p.:222-223℃ 実施例158

(1)実施例2で得られた化合物250mg及び4-ア ミノメチルー2-メチルピリジン309mgを135℃ で、6時間撹拌する。反応液に酢酸エチル及び水を加え 抽出し、抽出液を洗浄、乾燥後、溶媒を留去する。残渣 をシリカゲルクロマトグラフィー(溶媒;クロロホル ム:メタノール=9:1)で精製することにより、アモ ルファス状の(a)3-メトキシカルボニル-1〔(2-メチルピリジン-4-イル)メチルアミノ〕-7-(2-ピリジルメトキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)イソキノリン62mg及び(b)1-[(2-メチルピリジン-4-イル)メチルアミノ〕-3-[(2-メチルピリジン-4-イル)メチルカルバモイル〕-7-(2-ピリジルメトキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)イソキノリン70mgを得る。

【0256】(b) m. p. :185-186℃

(2)上記(1)で得られた化合物(a)53mgのクロロホルム1ml溶液に、氷冷下、4M塩化水素-酢酸エチル0.1mlを加え、5分間撹拌する。反応液を濃縮し、残渣に酢酸エチルを加え、ろ取することにより3ーメトキシカルボニルー1ー〔(2ーメチルピリジンー4ーイル)メチルアミノ〕-7-(2-ピリジルメトキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)イソキノリン・3塩酸塩48mgを得る。

【0257】m. p. :200-203℃(分解) 実施例159

実施例1で得られた化合物130mg及びイソニペコット酸エチル2mlを130~140℃で6時間撹拌する。反応液を水に注ぎ、10%クエン酸水溶液を加えた後、酢酸エチルを加え抽出する。抽出液を洗浄、乾燥後、溶媒を留去する。残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(溶媒;クロロホルム:酢酸エチル=2:1)で精製することにより、(a)7ーベンジルオキシー1ー(4ーエトキシカルボニルピペリジノ)-3ーメトキシカルボニルー4ー(3,4,5ートリメトキシフェニル)イソキノリン36.6mg及び(b)7ーベンジルオキシー1ー(4ーエトキシカルボニルピペリジノ)-4ー(3,4,5ートリメトキシフェニル)イソキノリン36カルボニルピペリジノ)ー4ー(3,4,5ートリメトキシフェニル)イソキノリンー3ーカルボン酸30mgを得る。

【0258】(a) m. p. :151-152℃ (b) m. p. :200-202℃ 実施例160

(1)実施例110で得られた化合物500mgのクロロホルム7ml溶液に、3-クロロ安息香酸290mgを加え、室温で3時間撹拌する。反応液を濃縮し、残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(溶媒;クロロホルム:メタノール=10:1)で精製することにより、7ーヒドロキシー3ーメトキシカルボニルー1-(N-オキソー3ーピリジル)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)イソキノリンを得る。

【0259】(2)上記(1)で得られた化合物、2-ピコリルクロライド・塩酸塩276mg及び炭酸カリウム463mgのジメチルホルムアミド10ml溶液を50℃で3時間撹拌する。反応液に水及び酢酸エチルを加えて抽出し、抽出液を洗浄、乾燥後、溶媒を留去する。残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(溶媒;クロロホルム:メタノール=20:1)で精製することにより、

3ーメトキシカルボニルー1ー(Nーオキソー3ーピリジル)-7ー(2ーピリジルメトキシ)-4ー(3、4、5ートリメトキシフェニル)イソキノリンを得る。【0260】(3)上記(2)で得られた化合物のクロロホルム3m1溶液に、4M塩化水素一酢酸エチル溶液0、5m1を加え、室温で1分間撹拌する。反応液を濃縮し、残渣にアセトンを加え、ろ取することにより3ーメトキシカルボニルー1ー(Nーオキソー3ーピリジル)-7ー(2ーピリジルメトキシ)-4ー(3、4、5ートリメトキシフェニル)イソキノリン・塩酸塩136mgを得る。

【0261】m. p. :194-199℃(分解) 実施例161

実施例110で得られた化合物362mgとNーオキソー2ーピコリルクロライド140mgとを、実施例160(2)及び(3)と同様に処理することにより、3ーメトキシカルボニルー7ー(Nーオキソー2ーピリジルメトキシ)ー1ー(3ーピリジル)ー4ー(3.4.5ートリメトキシフェニル)イソキノリン・塩酸塩323mgを得る。

(1) 実施例110で得られた化合物394mg及びピ

【0262】m. p. :216-221℃(分解) 実施例162

リジン214μlの塩化メチレン5ml溶液に、5℃以 下でトリフルオロメタンスルホン酸無水物178μ1を 加え、○℃で30分間撹拌する。反応液に塩化メチレン 及び飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加えて抽出する。 抽出液を洗浄、乾燥後、溶媒を留去することにより、3 ーメトキシカルボニルー1ー(3-ピリジル)-7-ト リフルオロメタンスルホニルオキシー4-(3,4,5 - トリメトキシフェニル) イソキノリンを得る。 【0263】(2)上記(1)で得られた化合物、2-ピリジルエチレン186mg、酢酸パラジウム40m g、1,1'-ビス(ジフェニルホスフィノ)フェロセ ン195mg及びトリエチルアミン245μ1のジメチ ルホルムアミド5m1溶液を、窒素ガス雰囲気下、10 ○℃で一夜撹拌する。反応液に酢酸エチル及び水を加 え、セライトろ過した後、ろ液を抽出する。抽出液を洗 浄、乾燥後、溶媒を留去する。残渣をシリカゲルクロマ トグラフィー(溶媒;クロロホルム:アセトン=2: 1)で精製し、ジエチルエーテルで結晶化することによ り、粉末状の3-メトキシカルボニル-1-(3-ピリ ジル)-7-[2-(2-ピリジル)エチレニル]-4 - (3,4,5-トリメトキシフェニル)イソキノリン 及び3-メトキシカルボニル-1-(3-ピリジル)-7-(1-(2-ピリジル) エチレニル) -4-(3.4,5-トリメトキシフェニル)イソキノリンの混合物 168mgを得る。

【0264】(3)上記(2)で得られた混合化合物1 00mgのテトラヒドロフランーメタノール混合溶液 (1:1)14m1に10%パラジウムー炭素30mgを加え、水素雰囲気下(1気圧)、室温で一夜撹拌する。反応液からパラジウムー炭素をろ去した後、ろ液を濃縮し、残渣をNHーシリカゲルクロマトグラフィー(溶媒;酢酸エチル:ヘキサン=5:3)で精製することにより、(a)3-メトキシカルボニルー1ー(3ーピリジル)-7ー〔1ー(2ーピリジル)エチル〕ー4ー(3,4,5ートリメトキシフェニル)イソキノリン及び(b)3-メトキシカルボニルー1ー(3ーピリジル)-7ー〔2ー(2ーピリジル)エチル〕ー4ー(3,4,5ートリメトキシフェニル)イソキノリンを得る。

【0265】(4)上記(3)で得られた化合物(a) 及び(b)をそれぞれ、実施例58(2)と同様に処理 することにより、(a)3-メトキシカルボニルー1-

(b) m. p.:207-210℃(分解)

実施例163~164

対応原料化合物を実施例137(1)と同様に処理する ことにより、下記第24表記載の化合物を得る。

[0267]

【表24】

【0268】参考例1

2-クロロピリジン5gとエチレンジアミン26.2gの2ープロパノール溶液100を室温で8時間撹拌する。反応液から溶媒を留去した後、残渣に水及びクロロホルムを加え抽出する。抽出液を洗浄、乾燥後、溶媒を留去する。残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(溶媒;クロロホルム:メタノール:水酸化アンモニウム=950:45:5)で精製することにより、油状のN¹ーピリミジン-2-イル-1,2-ジアミノエタン4.41gを得る。

【0269】参考例2

(1)1-ベンジルオキシカルボニルー3-ヒドロキシメチルモルホリン135mgのテトラヒドロフラン溶液1mlに、ヨウ化メチル140μ1を0℃で加え、次いで水素化ナトリウム24mgのテトラヒドロフラン溶液3mlを加えて0℃で3時間撹拌する。反応液を氷水に注ぎ、酢酸エチルを加え抽出し、抽出液を洗浄、乾燥後、溶媒を留去する。残渣をシリカゲルクロマトグラフ

ィー(溶媒;クロロホルム:酢酸エチル=5:1)で精製することにより、油状の1ーベンジルオキシカルボニルー3ーメトキシメチルモルホリン129mgを得る。【0270】(2)上記(1)で得られた化合物119mg及び10%パラジウムー炭素30mgのメタノール懸濁液3m1に、水素雰囲気下(1気圧)、室温で3時間撹拌する。反応液より、パラジウムー炭素をろ取し、ろ液を濃縮することにより、油状の3ーメトキシメチルモルホリン34mgを得る。

【0271】参考例3

(1)8-ベンジルオキシー3,4-ジヒドロー3-ヒドロキシー4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)イソクマリン-3-カルボン酸500mgおよび酢酸アンモニウム802mgの酢酸5ml溶液を60℃で2時間撹拌する。反応液に10%クエン酸水溶液、酢酸エチルおよびテトラヒドロフランを加え抽出する。抽出液を洗浄、乾燥後、溶媒を留去し、残渣にジエチルエーテルを加えてろ取することにより、8-ベンジルオキシー

1,2-ジヒドロー1-オキソー4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)イソキノリン-3-カルボン酸360mgを得る。

[0272] m. p. :231-234℃

(2)上記(1)で得られた化合物200mgの塩化メチレン5ml溶液に、1,3-ジシクロヘキシルカルボジイミド112mgを加え、室温で30分間撹拌する。反応液にメタノール1mlを加え、30分間加熱還流する。反応液を室温まで冷却した後、濃縮して、残渣に飽

和炭酸水素ナトリウム水溶液および酢酸エチルを加え抽出する。抽出液を洗浄、乾燥後、溶媒を留去し、残渣にジエチルエーテルおよびエタノールを加えてろ取することにより、8-ベンジルオキシー1,2-ジヒドロー3-メトキシカルボニルー1-オキソー4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)イソキノリン106mgを得る。

[0273] m. p. :171-173℃

フロン	トペー	ジの続き
-----	-----	------

(51) Int. Cl. ⁷	識別記号	FΙ	テーマコード(参考)
CO7D 401/04		C O 7 D 401/04	
401/12		401/12	
401/14		401/14	
405/12		405/12	
413/04		413/04	
// A 6 1 K 31/47	604	A 6 1 K 31/47	604
	605	•	605
31/495	601	31/495	601
31/505	601	31/505	601
31/535	606	31/535	606
31/55	604	31/55	604

(72)発明者 吉川 公平

埼玉県川口市北原台2丁目22番地4号

Fターム(参考) 4CO34 ANO1

4C063 AA01 AA03 BB01 BB02 BB08 BB09 CC15 CC25 CC29 CC34 CC54 CC57 CC73 DD03 DD12 DD15 EE01

4C086 AA03 BC30 GA02 GA07 GA08 GA09 MA04 NA14 ZA36 ZA39

ZA45 ZA81 ZC02